พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140ที่เคลือบผิว ด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

นางสาวชลธิชาแก้วหาญ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555

CORROSION BEHAVIOR OF AISI 4140 STEELSURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOR DEPOSITION

ChonthichaKeawhan

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirementsfor the Degree of Master of Engineering in Metallurgical Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2012

พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิว ด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> (อ. คร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์) ประธานกรรมการ (ผศ. คร.พรวสา วงศ์ปัญญา) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) (ผศ. คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์) กรรมการ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(รศ. คร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล) กรรมการ

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(ศ. คร.ชูกิจ ถิ่มปีจำนงก์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ้ชลธิชา แก้วหาญ: พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพ(CORROSION BEHAVIOR OF AISI 4140 STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOR DEPOSITION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา,155หน้า.

้ชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่มีความหยาบพื้นผิวแตกต่างกันถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ้โครเมียมในไตรค์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ด้วยกระบวนการเกลือบทางไอกายภาพโดย คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ก่อนทคสอบการ กัดกร่อนถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมแล้ว ์ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูก เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ในสารละลายโซเดียมกลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า พื้นผิวของชิ้นงานหลังทดสอบการ กัดกร่อนถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคเอกซ์เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโครปีจากการวิจัยพบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถกเกลือบผิว ด้วยโครเมียมในไตรค์และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรค์มี ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวและชิ้นงาน เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่า ชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรด์ที่ทุกค่าพีเอช ค่าความหยาบของ ้เหล็กกล้า 4140 ก่อนการเคลือบผิวที่ลคลงและสารละลายที่มีค่าพีเอชเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมี ้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น นอกจากนี้พบว่าพื้นที่ถูกกัดกร่อนและปริมาณผลิตภัณฑ์การ กัดกร่อนบนพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และ ้ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรค์มีปริมาณน้อยกว่าชิ้นงาน ้เหล็กกล้ำAISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และค่าความหยาบผิวที่ลดลงและสารละลายที่มีค่าพีเอชเพิ่ม มากขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมีพื้นที่ถูกกัดกร่อนและปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่ลดลงอีกด้วย

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมโลหการ</u>	ลายมือชื่อนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

CHONTHICHAKEAWHAN : CORROSION BEHAVIOR OF AISI 4140 STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOR DEPOSITION. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. PORNWASA WONGPANYA, Dr.-Ing., 155PP.

CORROSION/CHROMIUM NITRIDE FILM/TITANIUM NITRIDE/SURFACE ROUGHNESS/PVD

The AISI 4140 steel samples with different surface roughnesses were coated with CrN and TiN films by physical vapor deposition. The CrN and TiNcoated samples were characterized by X-ray diffraction techniqueand atomic force microscopyprior to corrosion testing. Then, the corrosion behavior of the uncoated, CrN and TiN coated AISI 4140 steel samples was studied in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2 7 and 10 by electrochemical technique. The surface of sample after corrosion testing was examined by the scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. From the results, the results revealed that the CrN and TiN coated AISI 4140 steel samples exhibited better corrosion resistance than the uncoated samples. The CrN coated AISI 4140 steel samples at all pH values. Decrease of surface roughness of AISI 4140 steel prior to coating and increase of solution pH result in better corrosion resistance. Moreover, the corroded area and corrosion products on the surface of CrN and TiN coated AISI 4140 steel samples were less than thoseof the uncoated samples. Decreases of thesurface roughness of AISI 4140

steel prior to coating and increases of the pH values of the solution resulted in less corroded area and corrosion products.



School of <u>Metallurgical Engineering</u>

Academic Year 2012

Student's Signature_	
<i>c</i> <u> </u>	

Advisor's Signature_____

Co-advisor's Signature_____

กิตติกรรมประกาศ

สำหรับวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้าน วิชาการและด้านการดำเนินงานวิจัย จากหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆในโอกาสนี้ผู้วิจัยขอขอบ พระคุณหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ให้ทุน สนับสนุนในการดำเนินการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ทาง วิชาการในค้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งตลอดการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โคยให้ความรู้ในค้านกระบวนการ เคลือบผิวค้วยวิธีไอทางกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ คร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล ผู้จัคการระบบลำเลียงแสง BL3.2b: PEEM สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนผู้ให้องค์ความรู้ทางวิชาการในด้านแสงซินโครตรอน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเครื่องมือ 6) และ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีทคลอง 3.2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ซึ่งให้คำแนะนำ ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

สำหรับคุณงามความคือันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับบิดา มารดา ตลอดจนญาติพี่น้องอันเป็นที่เการพรักยิ่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การทำวิจัยครั้งนี้สำเร็จอุล่วงได้ด้วยดี

ชลธิชาแก้วหาญ

สารบัญ

บทคัดย่	่อ (ภาษา	ใทย)ก	
บทคัดย่	ปทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)บ		
กิตติกร	้ กิตติกรรมประกาศง		
สารบัญ			
สารบัญ	ตาราง	ល្	
สารบัญ	รูปภาพ .	۔ ۹	
บทที่	α υ	~~	
1	บทน ำ.	1	
-	11	ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 1	
	1.2	าัตกงไระสงค์ของการวิจัย	
	1.2		
	1.5	ประโยญร์เพื่อวอาวอะได้รับอาออารวิอัย	
	1.4	อง ส่ส่ พ	
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		
	2.1 กระบวนการเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ		
		2.1.1 Evaporating	
		2.1.2 Sputtering	
		2.1.3 Ion Plating	
	2.2	กระบวนการการกัดกร่อน7	
		2.2.1 การกัดกร่อนแบบรูเข็ม10	
	2.3	การวัดศักย์ใฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า	
		การกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อน	
	2.4	เส้นโพลาไรเซชัน 14	
	2.5	การวิเอราะห์สับเอลือน	
	2.5	ער איז	

2.5.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)16

หน้า

		2.5.2 กล้องจุลทรรศน์ โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี	
		(Photoelectron Emission Spectroscopy, PES)1	7
	2.6	การทบทวนวรรณกรรม (reviewed literature) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง1	8
3	วิธีดำเ	เนินการวิจัย2	7
	3.1	วัสคุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการคำเนินการวิจัย	7
		3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการคำเนินการวิจัย2	7
		3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการคำเนินการวิจัย	7
	3.2	อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำเนินการวิจัย2	8
		3.2.1 อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่างก่อนการเกลือบผิว	8
		3.2.2 อุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบผิว	0
		3.2.3 อุปกรณ์สำหรับทคสอบการกัคกร่อน	3
		3.2.4 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบพื้นผิว	5
	3.3	ขั้นตอนการคำเนินการวิจัย	9
		3.3.1 ขั้นการเตรียมชิ้นงานก่อนการเกลือบผิว	0
		3.3.2 ขั้นตอนกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพ4	6
		3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวก่อนทดสอบการกัดกร่อน	8
		3.3.4 ขั้นตอนการทดสอบการกัดกร่อน	8
		3.3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวหลังทคสอบการกัคกร่อน	1
4	ผลกา	รวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย52	2
	4.1	กุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่เกลือบบน	
		เหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน5	2
		4.1.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	
		ที่เกลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทกนิก	
		การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)52	2

¥

	4.1.2 การวิเคราะห์กุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์
	ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์
	แบบแรงอะตอม (AFM)53
	4.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้อง
	จุลทรรศน์แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM)56
4.2	กุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เกลือบบน
	เหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน
	4.2.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์
	ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทคนิค
	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)57
	4.2.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์
	ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์
	แบบแรงอะตอม (AFM)58
	4.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบาง
	ไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้อง
	จุลทรรศน์แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM)61
4.3	พฤติกรรมการกัดกร่อน62
	4.3.1 ผลของการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และฟิล์มบาง
	ไทเทเนียมในไตรค์บนเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีต่อ
	พฤติกรรมการกัดกร่อน69
	4.3.2 ผลของก่ากวามเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายโซเดียมกลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน75
	4.3.3 ผลของค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้ำ AISI 4140
	ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน81

	4.4	คุณลัก	าษณะของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน	
		เหล็กเ	กล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ใน ไตรด์	
		และชิ้	นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง	
		ไทเทเ	นียมในไตรค์หลังทคสอบการกัคกร่อน86	5
		4.4.1	การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่	
			ถูกเกลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วย	
			ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140	
			ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ด้วยกล้อง	
			จุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)80	6
		4.4.2	การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	
			ที่เกลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทกนิก	
			X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)	6
		4.4.3	การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์	
			ที่เกลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทกนิก	
			X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)9	7
5	บทสรู	รุปและข้อ	อเสนอแนะ	0
	5.1	สรุปผล	การวิจัย10	0
	5.2	ข้อเสนย	บแนะ10	1
รายการ	อ้างอิง			2
ภาคผน	วก			
ภา	ุลผนวก	ี่ กิ.	การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	
			และการคำนวณอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า	
			AISI 4140 ชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วย	
			ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหลีกกล้ำ AISI 4140	
			ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์108	8

ภาคผนวก ข.	ข้อมูลดิบที่ได้จากการวัดเส้นโพลาไรเซชันที่ทำการทดลอง
	จากเครื่องโพเทนชิโอสแตท111
ภาคผนวก ค.	ค่าพีเอชของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว
	ชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140 ที่ถูก
	เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ก่อน
	และหลังการทคสอบการกัคกร่อน115
ภาคผนวก ง.	ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ
	ผิวชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140ที่ถูก
	เคลือบผิวค้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ก่อน
	ทคสอบการกัคกร่อน118
ภาคผนวก จ.	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค EDX ของชิ้นงาน
	เหล็กกล้า AISI4140 ชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว
	ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140
	ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์
	ก่อนและหลังการทคสอบการกัคกร่อน120
ภาคผนวก ช.	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์145
ประวัติผู้เขียน	

สารบัญตาราง

ตารางที่

2.1	ความหนาของ โครเมียมในไตรด์ฟิล์มและความหยาบผิวของ	
	ชิ้นงานตัวอย่างก่อนและหลังการเกลือบผิว	26
3.1	ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้ำ AISI 4140	27
3.2	ค่าความแข็งของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน	42
3.3	ผลการวัดก่ากวามหยาบพื้นผิวของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนการเกลือบผิว	43
3.4	ผลการวัคค่าความหยาบพื้นผิวของชิ้นงานหลังการเคลือบผิวค้วยฟิล์มบาง	
	โครเมียมในไตรด์	44
3.5	ผลการวัคค่าความหยาบพื้นผิวของชิ้นงานหลังการเคลือบผิวค้วยฟิล์มบาง	
	ไทเทเนียมในไตรด์	45
3.6	ตัวแปรในการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ (CrN) ในกระบวนการ	
	เคลือบผิวแบบไอทางกายภาพ	47
3.7	ตัวแปรในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ (TiN) ในกระบวนการ	
	เคลือบผิวแบบไอทางกายภาพ	47
3.8	จำนวนชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวและสภาวะที่ใช้ทดสอบการกัดกร่อน	50
3.9	จำนวนชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และสภาวะที่ใช้	
	ทดสอบการกัดกร่อน	50
3.10	จำนวนชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไนไตรด์และสภาวะที่ใช้	
	ทดสอบการกัดกร่อน	50
4.1	ค่าที่ได้จากเส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูก	
	เคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง	
	โครเมียมในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว	
	ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่ทำการทดสอบการกัดกร่อนใน	
	สารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนัก	
	ที่มีค่าพีเอช 2 7 และ 10	68

หน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
V.1	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเคียมคลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2112
ข.2	ค่าอัตราการกัคกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2112
ข.3	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเคียมคลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7113
ข.4	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7113
ข.5	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10114
ข.6	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10114
ค.1	ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140116
ค.2	ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการกัคกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า
	AISI 4140 ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์
ค.3	ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า
	AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์117

สารบัญรูป

หน้า

2.1	กลไกการทำ Sputtering6
2.2	องค์ประกอบของเซลล์การกัดกร่อนของโลหะ8
2.3	คลอไรด์ในน้ำที่มีผลต่อการกัดกร่อนในโลหะ10
2.4	รูปแบบการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion)11
2.5	การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน
	โดยเครื่องโพเทนชิโอสแตท12
2.6	ศักย์ใฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน14
2.7	ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโพลาไรเซชัน15
2.8	องค์ประกอบของ SEM16
2.9	ระดับชั้นพลังงานของ XPS17
2.10	เส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวและชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิว
	ด้วยชั้นเคลือบ Cr-(C,N) ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์19
2.11	เส้นแอโนดิกโพลาไรเซชันของชั้นเกลือบต่างๆในกรคซัลฟูริกความเข้มข้น
	0.1 โมลาร์ที่อัตราการสแกน 0.2 มิลลิโวลต์ต่อวินาที
2.12	อัตราการกัดกร่อนที่ได้จากการทดสอบจุ่มแช่ในสารละลาย
	โซเดียมคลอไรด์ที่ก่า pH ต่างๆ23
2.13	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิด Hydrogen evolution กับค่า pH
3.1	เตาอบชิ้นงาน
3.2	เครื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานหมุนยี่ห้อ BUEHLER รุ่น ECOMET 6
3.3	กระคาษทรายที่ใช้ในการขัคผิวชิ้นงาน
3.4	เครื่องวัดความหยาบผิวแบบใช้แสง
3.5	เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบรีแอคตีฟคีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

รูปที่

รูปที่	หน้า
3.6	ส่วนประกอบของระบบสุญญากาศ
3.7	ส่วนประกอบของระบบเคลือบผิว
3.8	เครื่องโพเทนชิโอสแตท
3.9	อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode)34
3.10	อิเล็กโทรดวัดกระแส (counter electrode)
3.11	อิเล็กโทรดตัวอย่าง (working electrode)
3.12	กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (optical microscope)
3.13	กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (scanning electron Microscope, SEM)
3.14	กล้องจุลทรรศน์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี
	(photoelectron emission spectroscopy, PES)
3.15	แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย
3.16	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนอบชุบทางความร้อน
	(กำลังขยาย 50 เท่า)41
3.17	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 หลังอบชุบทางความร้อน
	(กำลังขยาย 50 เท่า)41
3.18	แผนภาพการต่อเซลล์ทคสอบการกัคกร่อน
4.1	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์53
4.2	การหาค่าความหนาของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์54
4.3	ลักษณะเกรนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรด์
4.4	การหาขนาดเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่
4.5	โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์
	ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 414057
4.6	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์
4.7	การหาก่ากวามหนาของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์

รูปที่	หน้า	I
4.8	ลักษณะเกรนของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ที่เคลือบบน	
	เหล็กกล้ำ AISI 414060	0
4.9	โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัคขวางของฟิล์มบางไทเทเนียมมในไตรค์	
	ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 41406	1
4.10	เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	3
4.11	เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7	3
4.12	เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ในสารละลาย โซเดียมกลอ ไรด์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10	4
4.13	เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบค้วย	
	โครเมียมในไตรค์ผิวในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	4
4.14	เส้น โค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบค้วย	
	โครเมียมในไตรค์ผิวในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ -	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 76:	5
4.15	เส้น โค้ง โพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบด้วย	
	โครเมียมในไตรค์ผิวในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ -	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 106.	5
4.16	เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบค้วย	
	้ ไทเทเนียมไนไตรค์ผิวในสารละลายโซเดียมคลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	6

รูปที่	หน้	้ำ
4.17	เส้น โค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบค้วย	
	ไทเทเนียมในไตรค์ผิวในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 76	56
4.18	เส้น โค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบค้วย	
	ไทเทเนียมในไตรค์ผิวในสารละลายโซเคียมกลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 106	57
4.19	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	
	และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม	
	ในไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์กวามเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 27	0'
4.20	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	
	และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม	
	ในไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์กวามเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7	0'
4.21	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม	
	ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสารละลายโซเคียมกลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 107	'1
4.22	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม	
	ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 27	'2

รูปที่	หน้า
4.23	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเกลือบผิว
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม
	ในไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวค้วย
	ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 772
4.24	ค่าอัตราการกัคกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว
	ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม
	ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วย
	ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 1073
4.25	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5
	โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 1075
4.26	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบด้วย
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10
4.27	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบด้วย
	ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10
4.28	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบใน
	สารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5
	โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 1077
4.29	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบด้วย
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10

รูปที่	หน้า
4.30	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบด้วย
	ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสารละลายโซเคียมกลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10
4.31	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ไม่ถูกเกลือบผิวที่มี
	ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้ำ AISI 4140แตกต่างกันในสารละลาย
	โซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10
4.32	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรด์ ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกัน
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5
	โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 1083
4.33	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	ไทเทเนียมในไตรค์ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกัน
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5
	โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10
4.34	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่มีค่าความหยาบผิว
	ของเหล็กกล้ำAISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรค์
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10
4.35	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม
	ในไตรค์ที่ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลาย
	โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10
4.36	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม
	ในใตรด์ที่ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลาย
	โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10

รูปที่	r	เน้า
4.37	ภาพพื้นผิวของชิ้นงานเหลีกกล้ำ AISI 4140ที่ไม่ถูกเคลือบชิ้นงานเหลีกกล้า	
	AISI 4140 ที่ถกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์ และชิ้นงาน	
	เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์	
	ู้ ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5	
	โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	89
4.38	ภาพพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า	
	AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงาน	
	เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์	
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5	
	โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7	90
4.39	ภาพพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า	
	AISI 4140 ที่ถกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงาน	
	เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์	
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5	
	โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10	91
4.40	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน B1 หลังทุดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมกลอไรด์	
	ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	.93
4.41	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	.,,,
	ชิ้นงาน C1 หลังทดสอบการกัดกร่อนใบสารละลายโซเดียมคลอไรด์	
	ความเข้มข้มร้อยละ 3 5 โดยบ้ำหบักที่อ่าพีเอช 2	94
4 4 2	กาพก่าย SFM และผลการาิเคราะห้องค์ประกอบทางเคบีบบพื้นผิวของ	. 7 1
⊣.† ∠	จำเงาบ T1 หลังทดสอบการกัดกร่อบใบสารละลายโซเเดียบดลอไรด์	
	มผงาผ าา กแงกทแบบการกทกรอผ เผยารแอยกองกแอ เรท ดาาบเข้าข้าเรื้อยล∞ 3.5 โดยข้ำหนักที่ด่าพีเอซ ว	05
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.95

รูปที่	หน้า
4.43	ผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยด้วยฟิล์มบาง
	โครเมียมในไตรด์ก่อนและหลังทคสอบการกัดกร่อน
4.44	ผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยด้วยฟิล์มบาง
	ใทเทเนียมในไตรค์ก่อนและหลังทคสอบการกัคกร่อน
ก.1	วิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและและค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน
	จากเส้นโพลาไรเซชัน
٩.1	ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว
	ชิ้นงานเหล็กกล้ำAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์
	และชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
	ใทเทเนียมในไตรค์ก่อนทคสอบการกัดกร่อน119
จ.1	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2121
จ.2	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2122
จ.3	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B1 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7123
จ.4	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7124
จ.5	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B3 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 7125
จ.6	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B1 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10126
จ.7	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B2 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 10
จ.8	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ
	ชิ้นงาน B3 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 10

รูปที่		หน้า
จ.9	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 2	129
ə.10	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2	
จ.11	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C1 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7	
จ.12	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7	
จ.13	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7	
จ.14	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C1 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10	134
จ.15	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10	135
จ.16	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน C3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 10	136
จ.17	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2	137
จ.18	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2	138
จ.19	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T1 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7	139
ຈ.20	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7	140
ຈ.21	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7	141

รูปที่		หน้า
จ.22	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T1 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10	142
จ.23	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10	143
จ.24	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ	
	ชิ้นงาน T3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10	144



บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

เหล็กกล้า AISI 4140 เป็นเหล็กกล้าผสมต่ำที่มีความแข็งแรงสูงและมีความสามารถในการ ้ขึ้นรูปทางกลดี มีปริมาณของธาตุผสม คือ โครเมียม และ โมลิบดีนัม อยู่ในปริมาณที่ต่ำ จึงทำให้ เหล็กกล้า AISI 4140 มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าเครื่องมือชนิดอื่น เช่น H13 และ D2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเหล็กกล้าที่มีความต้านทานแรงคึงสูง สามารถทนแรงคึงได้ระหว่าง 800-1300 เมกะปาสกาล (MPa) สามารถชุบแข็งได้ทั้งชิ้นหรือเฉพาะที่ผิวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ การใช้งาน นิยมทำเป็นชิ้นส่วนทนแรงคึงสูงเช่น ชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น เพลาข้อ เหวี่ยง เฟือง เฟืองขับ เกียร์ สลัก เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้งานในสภาวะที่ มีการเสียคสี (abrasion) และการสึกหรอ (wear) จึงต้องการความแข็งที่ผิวเพื่อป้องกันการเสียคสี และการสึกหรอที่ผิว (Sivitski, A., Ajaots, M., Podra, P., 2008) แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการ (corrosion) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง กัดกร่อน ้คุณสมบัติทางด้านพื้นผิวของวัสดุเพื่อให้มีคุณสมบัติทางกลที่ดีขึ้นและมีความต้านทานต่อการ ้กัดกร่อนที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของวัสดุให้ยาวนานยิ่งขึ้น การปรับปรุง พื้นผิววัสดุให้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้นนั้นมีหลายวิธีที่ใช้ในภากอุตสาหกรรมปรับปรุง พื้นผิว เช่น คาร์โบในไตรค์ดิ่ง (carbonitriding) ในไตรค์ดิ่ง (nitriding) และการเคลือบผิวด้วย ใอทางเคมี (chemical vapor deposition, CVD) เป็นต้น แต่มีวิธีหนึ่งที่เป็นนิยมในอุตสาหกรรม ปรับปรุงพื้นผิววัสดุ คือ การเคลือบผิวไอทางกายภาพ (physical vapor deposition, PVD) ซึ่งเป็น ้กระบวนการที่สะอาค และชั้นเคลือบที่ผลิตจากกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพส่วนใหญ่จะ เป็นชั้นเคลือบของสารประกอบเซรามิค เช่น ไทเทเนียมในไตรค์ (TiN) ไทเทเนียมอะลูมิเนียม ์ ในไตรค์ (TiAIN) โครเมียมในไตรค์ (CrN) เป็นต้น ซึ่งเป็นชั้นเคถือบที่มีความแข็งสูง มีความ ทนทานต่อสารเคมี (chemical inert) และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี (thermal stability) ช่วยใน การปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนให้ดียิ่งขึ้น (Zhou, Q.G., Bai, X.D., Chen, X.W., Peng, D.Q., Ling, Y.H., Wang, D.R., 2003; Darja, K.M., Peter P., Miha, C., Marijan M., 2004) ้คุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของชั้นเกลือบจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวแปร เช่น วัสคุที่ถูก เคลือบผิว (substrate) ชนิดของสารประกอบของชั้นเคลือบ (chemical composition) ตัวแปรใน

กระบวนการเคลือบ (deposition parameters) โครงสร้างของชั้นเคลือบ (microstructure) เป็นต้น นอกจากนี้พฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งานอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ เคลือบผิวด้วยสารประกอบของชั้นเคลือบต่างชนิดกัน ได้แก่ โครเมียมในไตรค์และไทเทเนียมใน ไตรค์ และสนใจในการศึกษาสภาวะแวคล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยมีความสนใจใน การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนในสารละลายที่มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าความหยาบผิวของวัสดุมีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้น เคลือบทั้งสองชนิดเช่นไร

งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการเคลือบผิวบนเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีความหยาบผิวแตกต่าง กันด้วยชั้นเคลือบที่แตกต่างชนิดกัน ได้แก่ โครเมียมในไตรด์และไทเทเนียมในไตรค์ ต่อพฤติกรรม การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 % โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10 ด้วย เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical technique) คาดว่าผลสำเร็จของงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเลือกกรรมวิธีปรับปรุงพื้นผิว วัสดุให้เหมาะสมในแง่เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพ

1.2.2 เพื่อศึกษาผลก่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบที่ มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

1.2.3 เพื่อศึกษาผลของความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการเคลือบผิวที่มี ผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 1.3.1 โลหะที่ถูกเคลือบผิว หรือวัสดุพื้น (substrate) เพื่อปรับปรุงสมบัติที่ผิว คือ เหล็กกล้าเกรด AISI 4140 โดยมีขนาด คือ กว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร

1.3.2 กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวที่สนใจศึกษา คือ กระบวนการเคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพ โดยชั้นเคลือบผิวที่ต้องการศึกษา คือ ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์ม บางไทเทเนียมในไตรด์ โดยมีตัวแปรที่ต้องควบคุมดังนี้

- ก) ค่าอัตราส่วนระหว่างแก็สในโตรเจน และอาร์กอนคงที่
- ข) ค่าความคัน (pressure) คงที่
- ค) อุณหภูมิ (สำหรับวัสดุพื้น) ที่ใช้ในการเคลือบไอทางกายภาพคงที่ในที่นี้
 คือ อุณหภูมิห้อง
 - เวลาที่ใช้ในการเคลือบใอทางกายภาพคงที่
 - ความหยาบของพื้นผิววัสดุที่ถูกเกลือบ (roughness of substrate)

1.3.3 ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมชิ้นงานตามข้อ 1.3.2 แล้วทำการศึกษา กุณลักษณะพื้นผิว และส่วนผสมทางเคมี (chemical composition) ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ที่ได้จากกระบวนการเคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ โดย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM) เทคนิค X-ray diffraction (XRD) และเทคนิค atomic force microscopy (AFM)

1.3.4 ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพ ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีในสารละลายตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM Standard เป็นต้น โดยวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพเปรียบเทียบกับเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ยังไม่ผ่านเคลือบผิว แล้วแปล ความหมายจากเส้นโพลาไรเซชันที่วัดได้เป็นความหมายทางการกัดกร่อน กล่าวคือ วิเคราะห์หาค่า ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{cor}) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, I_{cor}) และค่าอัตราการกัดกร่อน (corrosion rate, R_{mmy})

 หลังจากนั้นตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกกัดกร่อน และส่วนผสมทางเคมีของชั้นเคลือบที่ ถูกกัดกร่อนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM) และเทคนิคเทคนิคเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโครปี (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบถึงพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้ำคาร์บอน AISI 4140 ที่เคลือบผิว ด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

1.4.2 ทราบถึงผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายที่มีต่อพฤติกรรมการ กัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

 1.4.3 ทราบถึงผลของความหยาบของผิวชิ้นงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของ เหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ 1.4.4 ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม
 โดยเฉพาะในการปรับปรุงพื้นผิวของโลหะเพื่อใช้งานด้านต้านทานการกัดกร่อน



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระบวนการเคลือบผิวแข็งด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ

กระบวนการเคลือบชั้นผิวแข็งของสารประกอบเซรามิกบนผิวชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ เพื่อเพิ่มความด้านทานต่อการสึกหรอ ความด้านทานต่อการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือทางวิศวกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (Medina-Flores, A., Arganis, C., Santiago, P., Oseguer., 2004) คือ

- การเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ (physical vapor deposition, PVD) ที่มี การสร้างผลิตอะตอมของสารเคลือบให้อยู่ในรูปของไอระเหยแล้วไปเคลือบอยู่บนผิวชิ้นงาน (substrate) ในระบบที่เป็นสุญญากาศ

 การเคลือบผิวแข็งด้วยไอเคมี (chemical vapor deposition, CVD) เป็น กระบวนการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยสารเคลือบที่อยู่ในสถานะก๊าซ โดยที่ก๊าซเหล่านี้จะทำปฏิกิริยา กันจนได้สารผลิตภัณฑ์แล้วเคลือบอยู่บนชิ้นงาน (substrate)ในงานวิจัยนี้กระบวนหลักที่ใช้เตรียม ผิวชิ้นงาน คือ การเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ (PVD) ดังนั้นจะกล่าวรายละเอียดอย่างย่อ เฉพาะกระบวนการเคลือบด้วยไอทางกายภาพเท่านั้น

การเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ เป็นกระบวนการที่กระทำในระบบสุญญากาศ และ อะตอมที่จะเคลือบบนผิวชิ้นงานจะมีการเกลื่อนที่โดยปราศจากการชน (collision) กัน ด้วยเหตุนี้ PVD จึงเป็น line-of sight process ส่วนการเคลือบผิวแข็งด้วยไอเคมี หรือ CVD process เป็น กระบวนการที่กระทำภายใต้ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) จึงสามารถควบคุมลักษณะ ชั้นเคลือบ และสามารถเคลือบชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีกว่ากระบวนการเคลือบด้วยไอทาง กายภาพ (PVD process)

อะตอมของชั้นเคลือบ (coating atom) จะถูกผลิตขึ้นในระบบสุญญากาศ กล่าวคือ เมื่อก๊าซ ที่ต้องการใช้เป็นวัสดุเคลือบ เช่น ในโตรเจน มีเทน หรือออกซิเจนถูกนำเข้าไปในหลอดสุญญากาศ อะตอมของโลหะก็จะทำปฏิกิริยากับอะตอมของก๊าซเพื่อฟอร์มไนตรายด์ คาร์ไบด์ หรือออกไซด์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบ (Roberts, G., 1998) คือ

2.1.1 Evaporating

evaporating กระทำโดยการนำเอาวัสดุต้นกำเนิดของชั้นเคลือบ ไปให้ความร้อน ในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ (10⁻⁶ kPa หรือ 7.5×10⁻⁶ torr) ทำให้เกิดการระเหยของอะตอม หรือ โมเลกุลภายในท่อระบบสุญญากาศแล้วเคลื่อนที่ไปเกาะบนผิวชิ้นงาน (substrate) อย่างไรก็ตาม กรรมวิธีที่ให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่าคือ sputtering หรือ ion plating

2.1.2 Sputtering

sputtering เป็น PVD coating process ที่อะตอมของวัสดุเคลือบถูกขับออกมาโดย อาศัยอะตอมที่มีพลังงานสูงคังแสคงในรูปที่ 2.1 โดยขั้นแรกภายในห้องเคลือบ (chamber) จะถูกทำ ให้เป็นสุญญากาศ หลังจากนั้นจะปล่อยก๊าซอาร์กอน (Ar gas) เข้าไป และวัสดุสำหรับเคลือบ (ในที่นี้ขอเรียกว่า target ดูรูปประกอบ) จะถูกทำให้เป็นขั้วลบ (cathode) โดยการป้อนศักย์ไฟฟ้า กระแสตรง (dc potential) ระหว่าง -500 ถึง -5000 โวลต์ ก็จะทำให้เกิด low-pressure glow discharge plasma ณ บริเวณรอบ ๆ วัสดุสำหรับเคลือบ (target cathode) แล้วปล่อยประจุบวกของ ก๊าซอาร์กอน (Ar⁺) ออกมา ซึ่ง Ar⁺ จะถ่ายเทโมเมนตัมให้กับวัสดุสำหรับเคลือน กระตุ้นให้วัสดุ สำหรับเคลือบปลดปล่อยอะตอมออกมาแล้วอะตอมนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปเกาะบนผิวชิ้นงาน (substrate) และบริเวณภายในของห้องเคลือบ



รูปที่ 2.1 กลไกการทำ sputtering (Robert, G., 1998)

2.1.3 Ion Plating

ion plating หมายถึง plasma-assisted PVD หรือ evaporative-source PVD process ซึ่ง plasma ที่เกิดขึ้นนี้จะอาศัยความร้อนในการกระตุ้นให้เกิดการระเหย การพุ่งเข้าชน (bombardment) ของ plasma ที่มีพลังงานสูงไปยังผิวชิ้นงาน (substrate) ทำให้ได้ชั้นเกลือบที่มีความ แน่น และการยึดเกาะ (adhesion) ที่ดีเยี่ยม

2.2 กระบวนการกัดกร่อน

การกัดกร่อน คือ การสูญเสียเนื้อ โลหะ โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อม อาจเป็น ปฏิกิริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง กล่าวคือ สินแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนพื้นโลกเป็นสภาพที่มีเสถียรภาพอยู่แล้ว เมื่อนำสินแร่เหล่านี้มาถลุง ให้ได้เนื้อโลหะบริสุทธิ์ทำให้โลหะอยู่ในสภาวะไม่มีเสถียรภาพมากขึ้น โลหะที่ไม่มีเสถียรภาพจะ พยายามกลับคืนสู่สภาพเดิม คือสินแร่ตามธรรมชาติที่มีเสถียรภาพสูงกว่า ซึ่งก็คือกระบวนการ กัดกร่อน จึงต้องใช้ความพยายามในการที่จะรักษาสภาพของโลหะเหล่านี้ให้เสื่อมสภาพเพราะการ กัดกร่อนน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานนาน

การกัดกร่อนของโลหะ (corrosion of metal) สามารถเกิดได้เมื่อครบสื่องค์ประกอบของ เซลล์การกัดกร่อน (corrosion cell) ดังแสดงในรูปที่ 2.2 คือ

- แอโนด (anode)
- แคโทด (cathode)
- อิเลคโตร ใลต์ (electrolyte)

- ตัวกลางในการถ่ายโอนอิเลคตรอน (electron transfer) หรือให้กระแสไฟฟ้า ใหลระหว่างขั้วแอโนด และขั้วแคโทด (metallic path)



รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของเซลล์การกัดกร่อนของโลหะ (AHMAD, Z., 2006)

ในกระบวนการการกัดกร่อนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical reaction) ที่มีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าหรือแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนในสารละลายของ น้ำหรือในน้ำ จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ของโลหะ (M) เกิดการ สูญเสียแรงยึดระหว่างอะตอมของโลหะนั้น แล้วอะตอมนั้นก็จะกลายเป็นอิเล็กตรอนหลุดเข้าไปใน สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) หรือปฏิกิริยาแอโนดิก (anodic reaction) นี้ จะเกิดขึ้นที่ขั้วแอโนด (anode) และปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction reaction) หรือ ปฏิกิริยาแกโทดิก (cathodic reaction) เกิดขึ้นที่ขั้วแกโทด (cathode) ซึ่งจะเป็นปฏิกิริยาที่รับ อิเล็กตรอน

ปฏิกิริยาออกซิเคชันของโลหะที่ถูกกัดกร่อนเป็น ดังนี้

 $M = M^{n+} + ne^{-1}$ (2.1)

้สำหรับปฏิกิริยารีคักชันจะแบ่งออกเป็นได้ 4 แบบ คังนี้

1) มีไฮโครเจนเกิดขึ้น (ภายในน้ำที่มีสภาพเป็นกรด)

$$2H^{+} + 2e^{-} = H_{2}$$
 (2.2)

2) เกิดรีดักชันของออกซิเจน (ภายในน้ำที่มีสภาพเป็นกรด)

 $O_2 + 4H^+ + 4e^- = H_2O$ (2.3)

3) เกิดรีดักชันของออกซิเจน (ภายในน้ำที่มีสภาพเป็นกลางและด่าง)

$$O_2 + 2H_2O + 4e^2 = 4OH^2$$
 (2.4)

4) เกิดรีดักชันของอิออนของโลหะ

$$M^{3+} + e^{-} = M^{2+}$$
 (2.5)

หลังจากการเกิดปฏิกิริยาของการกัดกร่อนเบื้องต้น ต่อไปก็คือการรวมตัวของไอออนใน สารละลาย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อน ตัวอย่างเช่น ในกรณีเหล็กที่เกิดการกัดกร่อนใน สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ปฏิกิริยาของการกัดกร่อนทั้งหมดจะเป็นไปตามสมการ (2.1) และ (2.4) รวมกัน ทำให้เกิดสารประกอบของเฟอร์รัสไฮดรอกไซด์ Fe(OH)₂ ขึ้นที่ผิวของเนื้อเหล็กตาม สมการที่ (2.6)

$$2Fe + O_2 + 2H_2O = 2Fe^{2+} + 4OH = 2Fe(OH)_2$$
 (2.6)

สารประกอบนี้ยังเกิดการออกซิเดชันได้อย่างรวดเร็วด้วยออกซิเจนที่มีอยู่ในระบบ ทำให้ เกิด Fe(OH)₃ ดังสมการ

$$2Fe(OH)_2 + H_2O + 1/2O_2 = 2Fe(OH)_3$$
 (2.7)

กระบวนการต่อไปก็คือ การที่สารประกอบนี้จะสูญเสียน้ำกลายเป็นสารประกอบตัวใหม่ กือ FeOOH หรือ Fe₂O₃*3H₂O (สนิมเหล็กสีแดง) แต่ถ้าปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอปฏิกิริยาจะไม่ ดำเนินไปจนได้ Fe₂O₃ แต่จะหยุดในรูปของ Fe₃O₄*nH₂O (สนิมเหล็กสีดำ) สำหรับการกัดกร่อนเมื่อมีคลอไรด์ร่วมด้วย (chloride assisted corrosion process) ในกรณี ที่น้ำมี Cl ผสมอยู่ในสารละลาย เมื่อโลหะสัมผัสกับโมเลกุลของ Cl จะถูกดูดซับไว้ที่ผิวโลหะ แทนที่จะเป็นโมเลกุลน้ำ จากนั้นจะเกิด MCl และทำปฏิกิริยาต่อไปในที่สุดจะได้ M²⁺ + 2e ดังรูปที่ 2.3 จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นแล้วเกิดก๊าซไฮโดรเจนเหมือนกับกรณีการกัดกร่อนในน้ำที่มี สภาพเป็นกรดทั่วไป ซึ่งกรณีที่มีคลอไรด์นี้จะไม่สามารถสร้างฟิล์มได้อีก กลไลนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆกัน และก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้จะเกาะอยู่ตามผิวของวัสดุซึ่งจะนำไปสู่การกัดกร่อน ต่อไป (อภิชิต พันธ์เสถียร, 2552)



รูปที่ 2.3 คลอไรค์ในน้ำที่มีผลต่อการกัดกร่อนในโลหะ (อภิชิต พันธ์เสถียร, 2552)

2.2.1 การกัดกร่อนแบบรูเข็ม

การกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) เป็นการกัดกร่อนแบบเกิดเฉพาะที่ที่มี ผลให้เกิดกวามเสียหายก่อนข้างรวดเร็วในบริเวณเฉพาะที่ ซึ่งเป็นปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะกับโลหะที่ได้พัฒนาให้มีฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนแบบทั่วผิวหน้า แต่เมื่อฟิล์มบาง แตกแยกออกเฉพาะบางที่ ก็จะเกิดการกัดกร่อนเฉพาะ ที่กัดกร่อนลึกลงไปเรื่อยๆ ทำให้สังเกตเห็น ได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนได้ปกคลุมเอาไว้ การกัดกร่อนแบบนี้ทำให้ทำนายได้ยาก โดยทั่วไปมักจะเกิดทิศทางเดียวกันกับแรงโน้วถ่วงของโลก การเกิดการกัดกร่อนในแนวอื่นก็เกิด ใด้แต่น้อย pitting เป็นลักษณะที่ทำให้เป็นรูหรือหลุมในเนื้อโลหะ รูเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ได้ แต่โดยส่วนมากจะมีขนาดเล็ก บางครั้งจะเห็นรูกระจายอยู่ห่างกัน หรืออาจอยู่ใกล้กันจนดู กล้ายผิวโลหะที่ขรุขระ pitting เป็นการกัดกร่อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายและรุนแรงที่สุด ซึ่งทำให้ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนต่างๆ เกิดความเสียหายเนื่องจาการเจาะลึกด้วยเปอร์เซ็นการสูญเสีย น้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดที่น้อย ลักษณะมักยากที่จะตรวจสอบพบยากเพราะมีขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังยากที่จะตรวจวัดเชิงปริมาณและ ตรวจวัดการขยายตัวของสภาพการกัดกร่อนของ pitting ได้ เพราะความลึกและจำนวนของรูที่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะเฉพาะสภาวะใดสภาวะหนึ่ง การเกิด pitting ยังยากที่จะทำนายได้จากการทดสอบในห้องทดลองอีกด้วย บางครั้งอาจใช้เวลานาน จึงปรากฏสภาพของการกัดกร่อน การเกิด pitting เป็นการเกิดเฉพาะที่และ เป็นรูปแบบการกัดกร่อน ที่รุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะเกิดอย่างฉับพลัน (Fontana, M.G., 1987) รูปแบบการ กัดกร่อนแบบรูเข็มในรูปแบบต่างๆ แสดงดังในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 รูปแบบการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) (ASTM-G46 standard, 2005)

2.3 การวัดศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อน

ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{cor}) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อัตรารวมของปฏิกิริยา แอโนดิกทั้งหมดเท่ากับอัตรารวมของปฏิกิริยาแคโทดิกโดยความหนาแน่นกระแสที่ศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อน เรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, I_{cor}) ซึ่งถือ เป็นตัวบ่งชื้อัตราการกัดกร่อน การวัดศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะเกิดการกัดกร่อน (ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์, 2544) ทำการวัดศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะเกิดการกัดกร่อน โดยใช้เครื่อง โพเทนชิโอสแตท (potentiostat) ซึ่งมีลักษณะการวัดดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนโดยเครื่อง โพเทนชิโอสแตท (ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์, 2544)

อิเล็กโทรคที่ใช้มี 3 ชนิคคือ

- ก) อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) คือ Ag/AgCl (3M KCl)
- ข) อิเล็กโทรดกระแส (counter electrode) คือ Pt หรือ คาร์บอน
- ค) อิเล็กโทรคตัวอย่าง (specimen) คือ ชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการทคสอบ
ค่าศักย์ไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงกับอิเล็กโทรด ตัวอย่าง ค่ากระแสไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบระหว่างอิเล็กโทรดกระแสกับอิเล็กโทรดตัวอย่าง จากค่าศักย์ไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ เมื่อนำมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ทั้งสองจะได้กราฟที่เรียกว่า กราฟเส้นโพลาไรเซชัน (polarization curve)

จากรูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของปฏิกิริยาแอโนดิก และปฏิกิริยาแคโทดิกบนพื้นผิวของโลหะที่กำลังเกิดการกัดกร่อน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขั้วไฟฟ้าที่ผิว ความต่างศักย์ของขั้วทั้งสองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังในเส้นกราฟแอโนดิก (anodic curve) และเส้นกราฟแคโทดิก (cathodic curve) ตามลำดับ โดยที่ความต่างศักย์ของแอโนดจะ เปลี่ยนค่าไปในทางบวก ส่วนความต่างศักย์ของแคโทดจะเปลี่ยนค่าไปในทางลบ ในลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงการเกิดโพลาไรเซชันของขั้วทั้งสอง (Fontana, M.G., 1987) สามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนได้จากจุดตัดของเส้นความชันของเส้นกราฟแอโนดและ เส้นกราฟแคโทด

เมื่อทราบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน แล้วสามารถหา อัตราการกัดกร่อน (Sedriks, A. J., 1996) ได้จาก

$$R_{mmy} = 0.00327 i_{corr} e / \rho$$

โดยที่	R _{mmy}	คือ	อัตราการเกิดการกัดกร่อน (มิลลิเมตรต่อปี)
	i _{corr}	คือ	ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน
		0	(ไมโกรแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร)
	e	คือ	น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ
	ρ	คือ	ความหนาแน่นของโลหะ (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)



รูปที่ 2.6 ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Sedriks, A.J., 1996)

2.4 เส้นโพลาไรเซชัน

(ประทีป วงศ์บัณฑิต, 2543) ได้ทำการศึกษากลไกพาสซิวิตี (passivity) ของเหล็กกล้า ไร้สนิม โดยศึกษาจากกราฟเส้นโพลาไรเซชันเมื่อทำการทดลองต่อจากรูปที่ 2.6 โดยเพิ่มศักย์ไฟฟ้า ไปทางโนเบิล (noble) จาก E_{cor} และบันทึกค่ากระแสที่ได้ จะได้ดังรูปที่ 2.7

จากกราฟรูปที่ 2.6 ทราบว่าจุดตัดของเส้นกราฟแคโทดิก และเส้นกราฟแอโนดิก คือ ค่า สักย์ไฟฟ้ากัดกร่อน หรือ E_{cor} เมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าต่อถึงจุดหนึ่ง กระแสกลับลดลงเนื่องจากเกิดชั้น ฟิล์มพาสสีฟบนผิวโลหะ เรียกค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดว่าเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงแอคทีฟ-พาสสีฟ (active-passive transition) และก่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าพาสซิเวชันปฐม (primarily passive potentials) ใช้สัญลักษณ์ E_{pp} ดังรูปที่ 2.7 เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าต่อไปกระแสจะเริ่มลดลงจน กงที่ที่ค่าหนึ่งแม้จะเพิ่มศักย์ไฟฟ้าให้แก่เซลล์ต่อไปความหนาแน่นของกระแสก็ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง ช่วงกราฟที่กระแสดงที่นี้เรียกว่าช่วงพาสสีฟ (passive zone) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะดัว ที่แสดงถึงความทนทานของฟิล์มบนผิวโลหะ ถ้ายังเพิ่มศักย์ไฟฟ้าต่อไปอีกจนถึงค่าหนึ่งที่ชั้นฟิล์ม พาสสีฟแตกทำให้กระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกช่วงที่เลยจุดนี้ว่า ช่วงทรานพาสสีฟ (tranpassive zone) และเรียกศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้ว่าศักย์ไฟฟ้าทรานพาสสีฟ ใช้สัญลักษณ์ E, ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เป็น ค่าที่โลหะเริ่มกัดกร่อนเฉพาะที่ คือ การกัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (pitting corrosion) ซึ่งหาก ป้อนศักย์ไฟฟ้าเกินค่า E, จะเกิดการแตกของชั้นฟิล์มพาสสีฟจุดใหม่เพิ่มขึ้น และชั้นฟิล์มจุดที่แตก เดิมจะมีการขยายตัวของรูเข็มหรือหลุมใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเส้นโพลาไรเซชันที่ได้จากการ ทดลองของโลหะตัวอย่างในสารละลายที่ไม่มีคลอไรด์ และสารละลายที่มีคลอไรด์พบว่าใน สารละลายที่มีคลอไรด์จะให้ค่า E, หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (pitting potential) ใช้สัญลักษณ์ E, ต่ำกว่า และมีความกว้างช่วงพาสสีฟแคบกว่าเส้นโพลาไรเซชันที่ ได้จากการทดลองในสารละลายที่ไม่มีคลอไรด์



รูปที่ 2.7 ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโพลาไรเซชัน (ประทีป วงศ์บัณฑิต, 2543)

2.5 การวิเคราะห์ชั้นเคลือบ

สำหรับการวิเคราะห์ชั้นเคลือบในการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) หรือ X-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM) และ scanning electron microscope (SEM) ซึ่งมีรายละเอียดคังนี้

2.5.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM)

ึกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เป็นเทคนิคที่สำคัญการ ตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นผิวของวัสดุและชั้นเคลือบ เนื่องจาก SEM มีกำลังขยายตั้งแต่ 20 – 30,000 เท่า และใช้กุณสมบัติกลื่นของอิเล็กตรอน สามารถวิเคราะห์ชั้นเกลือบในแนวลึกได้ กว่า 300 เท่าของกล้องจุลทรรศน์ปกติ ทำให้เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์ผิวในรายละเอียด หลักการ ทำงานของเครื่อง SEM จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนเพื่อ ้ป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่ม lens)เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็น อิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวบรวมรังสี (condenser ้ถำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของถำอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ หาก ต้องการภาพที่มีความคมชัดจะปรับให้ลำอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นลำอิเล็กตรอนจะถูก ปรับระยะโฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ลงไปบนผิวชิ้นงานที่ต้องการศึกษา หลังจาก ้ลำอิเล็กตรอนถูกกราคลงบนชิ้นงานจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) ขึ้นซึ่ง ้สัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอกนิกส์ และ ถูกนำไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไปและสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 องค์ประกอบของ SEM

2.5.2 กล้องจุลทรรศน์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (photoelectron emission spectroscopy, PES)

XPS ใช้แสงซินโครตรอนจะอยู่ในช่วงพลังงาน 50 -1000 eV จากระบบลำเลียง แสง BL3 ของห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยแสงในช่วงพลังงานดังกล่าวมีประโยชน์ในการศึกษา สภาวะทางเคมีที่ผิวหน้าสารทำให้สามารถระบุปฏิกิริยาตัวกลาง (intermediate reaction) ที่เกิดขึ้น บริเวณพื้นผิว และรอยต่อระหว่างพื้นผิวสารหรือการสึกหรือได้ การตรวจสอบดังกล่าวสามารถทำ ได้ เนื่องจากมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแยกแยะสเปกตรัม (spectral resolution) และความไว ในการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุจากการใช้แสงซิน โครตรอนที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าพลังงานได้ ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ระดับชั้นพลังงานของ XPS (Einstein, A., 1905)

2.6 การทบทวนวรรณกรรม (reviewed literature) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเคลือบผิวด้วยกระบวนการเคลือบด้วยไอทางกายภาพเป็นที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน สำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิววัสดุประเภทเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและเหล็กกล้าเครื่องมือ ชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่ชั้นเคลือบที่ได้จากกระบวนการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพจะเป็น สารประกอบประเภทในไตรด์ (Ibrahim, M.A.M., Korablov S.F., Yoshimura, M., 2002) ซึ่งเป็น ชั้นเคลือบที่มีคุณสมบัติทางด้านการด้านทานการสึกหรอและการด้านทานการกัดกร่อนที่ดี และ (Medina-Flores, A., Arganis, C., Santiago, P., Oseguera., 2004) ได้เสนอว่าผลของในไตรด์ที่ สามารถช่วยในการปรับปรุงการด้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานเกิดการละลายของชาตุ ในโตรเจนที่มีอยู่ในชั้นเคลือบในไตรด์ออกสู่สารละลาย และทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน (H⁺) ที่มีอยู่ในสารละลายกลายเป็นแอมโมเนียม (NH₄⁺) ทำให้สารละลายมีก่าความเป็นด่างมากขึ้นทำให้ อัตราการกัดกร่อนลดลง

Darja, K.M., Peter P., Miha, C., Marijan M. (2004) ได้ทำการศึกษาผลของเคลือบผิวด้วย โกรเมียม ในไตรด์ฟิล์มบนเหล็กกล้า (mild steel) และเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) โดย กระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพแบบ ion plating ต่อคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน จาก การทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 โม ลาร์ จะได้ผลการทดลองเป็นกราฟโพลาไรเซชั่น (polarization curves) ดังรูปที่ 2.11 ซึ่งแสดง กวามสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (current density) และสักย์ไฟฟ้า (potential) เปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานที่ยังไม่ผ่านการเคลือบผิว และชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยโครเมียม ในไตรด์ ภายหลังการเคลือบผิวเหล็กกล้าทั้งสองชนิดด้วยโครเมียมในตรายด์ฟิล์มนั้น ส่งผลให้ คุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้น เนื่องจากค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้นและ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนมีก่าลดลงภายหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มโครเมียมในไตรด์



รูปที่ 2.10 เส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวและชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ Cr-(C,N) ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ (Darja, K.M., Peter P., Miha, C., Marijan M. (2004))

Bertrand, G., Mahdjoub, H., Meunier, C. (2004) ได้ศึกษาผลของโครเมียมไนไตรด์ฟิล์ม ต่อคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเช่นเดียวกัน แต่โครเมียมไนไตรค์ฟิล์มนี้ได้มา จากกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพแบบ magnetron reactive sputtering จากการทดสอบด้วย วิธีทางเคมีไฟฟ้าพบว่าโครเมียมไนไตรด์ฟิล์มสามารถปรับปรุงคุณสมบัติการด้านทานการกัดกร่อน ของเหล็กกล้าให้ดีขึ้น โดยนักวิจัยกลุ่มนี้สรุปว่าโครเมียมไนไตรด์ฟิล์มจะแสดงพฤติกรรมเนื่อย และมีเสถียรภาพสามารถที่จะป้องกันชิ้นงานเหล็กกล้าจากการกัดกร่อนของสารละลายได้ แต่ก็ไม่ สามารถป้องการกัดกร่อนจากสารละลายได้อย่างสมบูรณ์ ในการศึกษานี้ยังกล่าวไว้อีกว่าการ ด้านทานการกัดกร่อนจองชั้นเคลือบจะถูกจำกัดด้วยข้อบกพร่อง (defect) และรูพรุน (porosity) ภายในโครงสร้างของชั้นเคลือบ นอกจากนี้ Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G. (2002) ยัง เสนออีกว่าการเกิดการกัดกร่อนของชั้นเคลือบโครเมียมไนไตรด์จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ ชั้นเคลือบ ได้แก่ โครงสร้างพื้นผิวและข้อบกพร่อง (รูพรุนหรือรูโพรง) ของชั้นเคลือบ ซึ่งส่งผล โดยตรงต่อการต้านทานการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ ปริมาณของรูพรุนจะสามารถประเมินจากค่า อัตราส่วนระหว่างค่า polarization resistance ของชิ้นงานที่ยังไม่เคลือบผิวและชิ้นงานที่ผ่านการ เคลือบผิวดังสมการ

	Р	=	Rp,u / Rp,r-u	(2.9)
โดย	P Rp.u	คือ คือ	ผลรวมของรูพรุนในชั้นเคลือบ (total coating porosity) ความต้านทานโพลาไรเซชันของชิ้นงาน	
	1 .		(polarization resistance of substrate)	
	Rp,r-u	คือ	ความต้านทานโพลาไรเซชันของชั้นเคลือบ	
			(polarization resistance of coating-substrate)	

นอกจากชั้นเคลือบชนิดโครเมียมในไตรด์ที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้วในหลายงานวิจัยแล้ว ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่สนใจในการศึกษาชั้นเคลือบที่ต่างชนิดกันออกไป เช่น Herranen, M., Wiklund U., Carlsson, J.O., Hogmark. (1998) ทำการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของไทเทเนียมในไตรด์ ฟิล์มที่เคลือบบนผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ พบว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบไทเทเนียมในไตรด์ฟิล์มจะแสดง การต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่า โดยมีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่สูงกว่า และค่าความหนาแน่น กระไฟฟ้าการกัดกร่อนที่น้อยกว่าชิ้นงานที่ยังไม่ผ่านการเคลือบผิว ดังแสดงในรูปที่ 2.12 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอที่ว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้าง ของชั้นฟิล์ม โครงสร้างของไทเทเนียมในไตรด์ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งยาว (columnar structure) ทำให้สารละลายมีโอกาสที่จะแพร่ และซึมผ่านเข้าไปในชั้นฟิล์มได้ง่าย ซึ่ง



รูปที่ 2.11 เส้นแอโนดิกโพลาไรเซชันของชั้นเคลือบต่างๆในกรคซัลฟูริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่อัตราการสแกน 0.2 มิลลิโวลต์ต่อวินาที. (Herranen, M., Wiklund U., Carlsson, J.O., Hogmark., 1998)

Yang, J., Ping Yu, G., Hong H.J. (2000) ได้ทำการศึกษาผลของการเกลือบผิวเหล็กกล้า ไร้สนิมด้วยไทเทเนียมในไตรด์ฟิล์มด้วยวิธี potentiodynamic polarization จากการศึกษาพบว่าเมื่อ เกลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรด์ฟิล์มแล้ว ทำให้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าไร้สนิมลดลงจาก 231.96 nA/cm² เป็น 195.9 nA/cm² หรือเกิดการกัดกร่อนน้อยลง นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของไทเทเนียมในไตรด์ฟิล์มจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะโครงสร้างของชั้นฟิล์ม และการยึดเกาะของชั้นฟิล์ม โดยกล่าวไว้ว่าโครงสร้างของชั้นฟิล์ม ที่มีปริมาณข้อบกพร่อง (defect) มากและการยึดเกาะระหว่างชั้นเคลือบและจิ้นงานที่ไม่ดีจะส่งผล ให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนลดน้อยลง และ Souto, R.M, Alanyali, H. (2000) ได้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการที่ชั้นเคลือบมีข้อบกพร่องหรือรูพรุนมากนั้น จะส่งผลให้สารละลายที่มีฤทธิ์ การกัดกร่อนสามารถแพร่และซึมเข้าสู่ชั้นเคลือบและแพร่ผ่านไปจนถึงตัววัสดุนำไปสู่การกัดกร่อน ในรูปแบบการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางการกัดกร่อนของชั้น เกลือบที่แตกต่างชนิดกัน โดย Cunha, L., Andritschky M., Rebouta L., Pischow. (1999) ได้ศึกษา พฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์ และไทเทเนียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่ผลิด จากกระบวนการเคลือบผิวแบบไอทางกายภาพ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการ เคลือบโครเมียมในไตรด์ และที่ผ่านการเกลือบไทเทเนียมอะลูมิเนียมในไตรด์ด้วยเครื่อง โพเทนซิโอสแตท (potentiostat) จากการทดสอบสรุปว่าชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์ด้วยเครื่อง โพเทนซิโอสแตท (potentiostat) จากการทดสอบสรุปว่าชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์ และได้ อธิบายถึงกลไกการกัดการกัดกร่อนของชั้นเคลือบในสารละลายกรดไฮโดรกลอริก จากผลการ ทดลองด้วยเทคนิก X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) พบว่าการกัดกร่อนเกิดขึ้นจากการ แพร่ของสารละลายผ่านข้อบกพร่อง (defect) ของชั้นเคลือบในรูปแบบการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) ทำให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนในชั้นเคลือบ และส่งผลให้ออกซิเจนสามารถ แพร่เข้าไปชั้นเคลือบและเกิดการออกซิเดชั่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนหรือออกไซด์ของ เหล็กได้

Liu, C., Bi, Q., Matthews, A. (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านทานการ กัดกร่อนของชั้นเคลือบไทเทเนียมในไตรด์และโครเมียมในไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.5 N โดยทำการ ทดสอบการ ด้านทานการ กัดกร่อนด้วยการ วัดความด้านทานเชิงซ้อน (ac impedance) ในการ จุ่มแช่ชิ้นงานที่เวลาแตกต่างกัน พบว่าก่าความด้านทานเชิงซ้อน (ac impedance) ของชิ้นงานที่เคลือบโครเมียมในไตรด์ และไทเทเนียมในไตรด์จะมีค่าลดลงเมื่อ เวลาในการ จุ่มแช่ชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น แต่ชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์จะไม่แสดงการลดลงอย่าง ชัดเจนในช่วงเวลาแรกเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นเคลือบไทเทเนียมในไตรด์ จากผลการทดลองนี้ผู้วิจัย จึงเสนอว่าชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์เกิดการกัดกร่อนได้ช้ากว่าชั้นเคลือบไทเทเนียมในไตรค์ ซึ่ง สอดคล้องกับผลการตรวจสอบโครงสร้างของชั้นเคลือบทั้งสองชนิด พบว่าลักษณะโครงสร้างของ ชั้นเคลือบไทเทเนียมในไตรด์จะมีลักษณะเป็นแท่ง (columnar structure) และผิวหยาบ มีรูพรุนท่ ส่วนชั้นเคลือบโครเมียมในไตรด์จะมีโครงสร้างที่หนาแน่นและสม่ำเสมอ มีรูพรุนที่น้อยกว่า ซึ่งจะ ทำให้สารละลายสามารถแพร่เข้าไปในชั้นเคลือบและเกิดการกัดกร่อนได้ยากกว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของวัสดุและชั้นเคลือบ นอกจากชนิดของ สารละลายแล้วยังขึ้นกับค่าความเป็นกรด-ค่าง (pH) ของสารละลายอีกด้วย ในงานวิจัยของ Hiroki, T. (2008) ได้ศึกษากลไกการกัดกร่อนขั้นต้น (initial stage) ของเหล็กในสภาวะที่เป็นน้ำและมี ออกซิเจนร่วมอยู่ด้วยจะสามารถอธิบายได้โดยกลไกทางเคมีไฟฟ้า เหล็ก (Fe) จะเกิดการละลาย ออกมาอยู่ในรูปของ Fe²⁺ และออกซิเจนจะถูกรีดิวซ์ฟอร์มเป็น OH⁻ และทำปฏิกิริยากันกลายเป็น เหล็กไฮดรอกไซด์ (Fe(HO)₂) มีลักษณะเป็นชั้นเจล (gel) ที่หนาสามารถป้องกันการแพร่ผ่านของน้ำ และออกซิเจนเข้าไปสัมผัสกับผิวหน้าเหล็กได้ยากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอัตราการกัดกร่อนลงได้ จาก การคำนวณทางสมดุล Fe(HO)₂ จะฟอร์มตัวขึ้นในสารละลายที่มีก่า pH เท่ากับ 9.31 หลังจากนั้นจะ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่สลายจาก Fe(HO)₂ ไปเป็น Fe(OH)₃ ที่มีลักษณะเป็นชั้นเจลที่บางหรือ สนิม ทำให้น้ำและออกซิเจนสามารถแพร่ผ่านได้ง่ายขึ้นไม่สามารถป้องการกัดกร่อนได้

ในงานวิจัยของ Altun, H., Sen, S.I. (2008) ได้ศึกษาอิทธิพลของค่า pH ต่อพฤติกรรมการ กัดกร่อนของโลหะผสมแมกนีเซียมโดยการจุ่มแช่ชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่แตกต่างกัน และพบว่าที่ก่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์หนึ่งๆก่า pH 2 จะแสดงก่าอัตราการ กัดกร่อนสูงที่สุด และก่าอัตราการกัดกร่อนจะลดลงเมื่อก่า pH เพิ่มสูงขึ้นตามลำคับคังแสดง ในรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.12 อัตราการกัดกร่อนที่ได้จากการทดสอบจุ่มแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ก่า pH ต่างๆ (Altun, H., Sen, S.I. (2008)

ผลการวิจัยในปีเดียวกันของ Ming, C.Z., Ming, L., Guang, L.S., Andrej, A. (2008) ยืนยัน ผลการศึกษาของอิทธิพลของค่า pH ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมแมกนีเซียม เช่นเดียวกัน และยังได้ศึกษาเพิ่มเติมของการเกิด H₂ evolution โดยการวัดก่าอัตราการเกิด H₂ evolution ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีค่า pH แตกต่างกันและจากการศึกษาพบว่าที่ สารละลายที่มีค่าความเป็นกรดสูง (pH = 3) อัตราการเกิด H₂ evolution จะมีค่ามากกว่าสารละลายที่ มีค่าความเป็นกลางและด่าง ดังแสดงผลในรูปที่ 2.14 ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่าอัตราการกัดกร่อน ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่า pH ลดลงอัตราการเกิด H₂ evolution และอัตราการกัดกร่อนจะมีค่าสูงขึ้น



รูปที่ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิด Hydrogen evolution กับค่า pH (Ming, C.Z., Ming, L., Guang, L.S., Andrej, A. (2008)

นอกจากนี้ผลการวิจัยทั้งของ Zaid, B., Saidi, D., Benzaid, A., Hadji, S. (2008) ได้รายงาน ถึงผลของค่า pH ต่อการเกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) ของโลหะผสมอะลูมิเนียม เกรด AA6061 ซึ่งปกติทั่วไปจะมีพฤติกรรมการเกิดพาสซีฟฟิล์ม (passive film) ที่มีความสามารถ ในการด้านทานการกัดกร่อนได้ ทำการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ที่มีค่า pH 2 6 และ 12 จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการกัดกร่อนของวัสดุจะขึ้นอยู่กับค่า pH ของสารละลาย ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบ รูเข็มหรือหลุมมีความสัมพันธ์กับความกว้างของช่วงพาสสีฟ โดยที่ค่า pH 12 มีความกว้างของช่วง พาสสีฟมากกว่าที่ค่า pH 2 และ 6 และมีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting potential) สูง กว่าที่ค่า pH 2 และ 6 เพราะในสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ 12 มี OH (hydroxyl group) ทำให้เกิด การซ่อมแซมตัวเองของพาสสีฟฟิล์ม

ความหยาบของพื้นผิววัสดุก็เป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางด้าน การกัดกร่อนของวัสดุ โดย Walter, R., Bobby, K. M. (2006) ได้ทำการเตรียมพื้นผิวของโลหะหล่อ ผสมแมกซีเซียมเกรด AZ91 ให้มีความหยาบผิวแตกต่างกันด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 600 1200 และผงเพชรความละเอียด 3 ไมครอน หลังจากนั้นนำไปทดสอบการกัดกร่อนใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า จากการ ทดสอบพบว่าชิ้นงานที่หยาบที่สุด (ขัดด้วยกระดาษเบอร์ 320) จะมีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า การกัดกร่อนมากที่สุด และค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนจะลดลงเมื่อความหยาบผิว วัสดุละเอียดขึ้น และพบว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวที่ละเอียดที่สุด (ขัดด้วยผงเพชรความละเอียด 3 ไมครอน) จะแสดงการเกิดพาสซีฟฟิล์ม (passive film) ซึ่งเป็นฟิล์มที่ช่วยในการป้องการกัดกร่อน จากสารละลาย ทำให้มีก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนน้อยที่สุด

Liu, C., Leyland, A., Lyon, S., Matthews, A. (1995) ได้ศึกษาผลของความหยาบผิวของ ้เหล็กกล้าก่อนการเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์ที่ผลิตด้วยกระบวนการไอกายภาพต่อพฤติกรรม การกัดกร่อน ก่อนการเคลือบผิวได้ทำการเตรียมผิวเหล็กกล้าให้มีความหยาบแตกต่างกัน ได้แก่ ขัด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ขัดด้วยผงเพชรขนาด 45 📃 ใมครอน และขัดด้วยผงเพชรขนาด 6 ไมครอน หลังจากนั้นทำการทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อย โดยน้ำหนักด้วยการวัดความต้านทานเชิงซ้อน (impedance) จากการศึกษาพบว่าเมื่อความ ถะ 3 ้หยาบผิวละเอียคมากขึ้นจะส่งผลให้การต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้น โดยมีข้อสันนิษฐานว่าชิ้นงานที่ ้มีความหยาบผิวละเอียดขึ้นอาจส่งผลให้พื้นผิววัสดมีปริมาณข้อบกพร่อง (defects) ที่น้อยลงส่งผล ให้ได้ชั้นเคลือบที่เรียบและมีการยึดเกาะที่ดีกว่ากับวัสดุ ทำให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความหนาแน่นและ ูสม่ำเสมอ สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีขึ้น ซึ่งสอคคล้องกับข้อสรุปของ Durst, O., Ellermeier, J., Berger, C. (2008) ที่มีข้อสรุปว่า เมื่อความหยาบผิวเพิ่มมากขึ้นจะเปรียบเสมือนการเพิ่มปริมาณ ้ข้อบกพร่องในชั้นเคลือบให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการต้านทานการกัดกร่อนของชั้น เคลือบลดน้อยลง ในปีต่อมา Shen-Chih, L., Wei-Yu, H., Lai, F.D. (1996) ได้มีการศึกษาผลของ ้ความหยาบพื้นผิววัสดุก่อนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบโครเมียมในใตรด์เช่นเดียวกันด้วยการ เตรียมพื้นผิววัสดุก่อนการเคลือบผิวที่แตกต่างกัน ก่อนและภายหลังการเคลือบผิวได้มีการวัดความ หยาบผิวของชิ้นงาน จะพบว่าความหยาบผิววัสดุก่อนการเคลือบผิวมีผลต่อความหยาบผิวของ ้ชิ้นงานภายหลังการเคลือบผิว ความหยาบผิวภายหลังการเคลือบผิวจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามความหยาบพื้นผิววัสดุก่อนการเกลือบผิว ดังแสดงผลในตารางที่ 2.1 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษา ผลของความหยาบผิวนี้ต่อคุณสมบัติการกัดกร่อนด้วยการทดสอบการกัดกร่อนโดยการจุ่มแช่ ชิ้นงาน จากการทดสอบการกัดกร่อนจะพบว่าชิ้นงาน A มีค่าอัตราการกัดกร่อนมากที่สุด (58 มิลลิกรัมต่อวัน) ตามด้วยชิ้นงาน B (25 มิลลิกรัมต่อวัน) และชิ้นงาน C (2 มิลลิกรัมต่อวัน) ที่ มีค่าอัตราการกัดกร่อนน้อยที่สุดตามลำดับ โดยเสนอเหตุผลที่ว่าการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ โกรเมียมในใตรด์บนชิ้นงานที่มีความหยาบผิวมากจะส่งผลให้โครงสร้างของชั้นเคลือบที่ได้มี ลักษณะเป็นแท่ง (columnar) และมีรูเข็ม (pinhole) ภายในชั้นเคลือบได้ง่ายกว่าการเคลือบผิวบน ชิ้นงานที่มีความหยาบที่ละเอียดกว่า

	ความหนาของ	ความหยาบผิว (Ra)		
ชิ้นงาน	โครเมียมในไตรค์ฟิล์ม (ไมโครเมตร)	ก่อนการเคลือบผิว	หลังการเกลือบผิว	
А	2.36	0.31	0.33	
В	2.36	0.20	0.22	
С	2.36	0.10	0.13	

ตารางที่ 2.1 ความหนาของโครเมียมในไตรค์ฟิล์มและความหยาบผิวของชิ้นงานตัวอย่างก่อน และหลังการเคลือบผิว

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการเคลือบผิว ด้วยไอทางกายภาพ วิธีการทดสอบการกัดกร่อน การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลต่างๆของวัสดุและ ชั้นเคลือบผิว รวมทั้งงานวิจัยที่ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ เช่น วัสดุที่ถูกเคลือบผิว (substrate) ความ หยาบผิวของวัสดุ (surface roughness) ชนิดของสารประกอบของชั้นเคลือบ (chemical composition) ตัวแปรในกระบวนการเคลือบ (deposition parameters) โครงสร้างของชั้นเคลือบ (microstructure) และสภาวะการใช้งานต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของวัสดุและชั้นเคลือบ ซึ่งจะเป็น แนวทางที่มีประโยชน์ต่อการคำเนินงานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ ซึ่งมีวิธีดำเนินงานวิจัย ตลอดจนผลการทดลองและการ วิเคราะห์ผลการทดลองดังแสดงในบทต่อไป

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยนี้สนใจพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ จึงเลือกใช้โลหะหรือวัสดุพื้น (substrate) ที่นำมาเคลือบผิว คือ เหล็กกล้า AISI 4140 ซึ่งเป็นเหล็กกล้าผสมต่ำที่มีความแข็งแรงสูงและมีความสามารถในการขึ้น รูปทางกลได้ง่าย โดยมีส่วนผสมทางเคมีดังในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเกมีของเหล็กกล้า AISI 4140

วัสคุ	ส่วนผสมทางเกมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)						
1822222 4101 4140	С	Si	Mn	Cr	Мо	V	Fe
190000 1 AISI 4140	0.470	0.260	0.780	0.810	0.190	0.0027	Balance

3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

ก) สารเคมีสำหรับการเตรียมตัวอย่าง

- กรคไนตริก (HNO3) ใช้สำหรับการกัดผิวหน้าชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ โครงสร้างจุลภาคก่อนและหลังกระบวนการอบชุบทางความร้อน

- อะซิโตน (CH₃COCH₃) เอทานอล และน้ำกลั่น ใช้สำหรับทำความ สะอาคชิ้นงานก่อนการเกลือบผิว การวิเคราะห์พื้นผิว และภายหลังการทดสอบการกัดกร่อน

- ชารเคมีสำหรับกระบวนการเคลือบผิว
 - ก๊าซอาร์กอน
 - ก๊าซไนโตรเจน
- ค) สารเคมีสำหรับการทดสอบการกัดกร่อน

- โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ใช้สำหรับการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 % โดยน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบ - กรคไฮโครคลอริก (HCl) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ใช้สำหรับปรับค่าพีเอช ของสารละลายให้มีค่าน้อยลง

- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 1.25 โมลาร์ ใช้สำหรับปรับ ค่าพีเอชของสารละลายให้มีค่ามากขึ้น

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้งานใน แต่ละขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

3.2.1 อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่างก่อนการเคลือบผิว

ก) เตาอบชิ้นงาน รุ่น CARBOLITE TYPE CWF 12/13 ใช้เป็นอุปกรณ์ใน
 กระบวนการอบชุบทางความร้อนให้กับชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
 โกรเมียมในไตรค์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 เตาอบชิ้นงาน

ง) เครื่องงัดผิวชิ้นงานแบบงานหมุนยี่ห้อ METKON FORCIPOL 2V
 GRINDER POLISHER ใช้เป็นอุปกรณ์ในการงัดหยาบและงัดละเอียดผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่
 กระบวนการเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และไทเทเนียมในไตรด์ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 เครื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานหมุนยี่ห้อ BUEHLER รุ่น ECOMET 6

กระดาษทรายเบอร์ 180 320 400 600 800 1000 และ 1200 ใช้ในการขัดหยาบ
 ผิวชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 กระดาษทรายที่ใช้ในการขัดผิวชิ้นงาน

 ง) เครื่องวัคความหยาบผิวแบบใช้แสงรุ่น WYKO NT1100 ยี่ห้อ VEEGO INSTRUMENT INC. ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ใช้ในการวัคความหยาบผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ผลที่ ได้จะแสดงค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ของชิ้นงานและภาพลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ



รูปที่ 3.4 เครื่องวัดความหยาบผิวแบบใช้แสง

3.2.2 อุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลื่อบผิว

 ก) เครื่องเคลือบระบบสุญญากาศระบบรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสบัตเตอริง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชั้นเคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง (sputtering) กระบวนการเคลือบด้วย ไอทางกายภาพ ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทค โนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

 ง) เครื่องเคลือบระบบสุญญากาศระบบรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนระบบสุญญากาศ (vacuum parts) และ ส่วนของระบบเคลือบ (coating parts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจากสแตน เลส ขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง 353.0 มิลลิเมตร สูง 370.0 มิลลิเมตร ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ ไอแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบกลโรตารีเป็นเครื่อง สูบท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดย ใช้หัววัดแบบพิรานีรุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050 ดังแสดงในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ส่วนประกอบของระบบสุญญากาศ

- ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และ ไทเทเนียมในไตรด์ประกอบด้วย หัวแมกนีตรอนกาโทด ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลาง 50.0 มิลลิเมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำติดตั้งเป้าโครเมียมและไทเทเนียม (99.97%) ที่คาโทด พร้อมภาคง่าย ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ใช้แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ ใช้แก๊ส ในโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สำหรับการง่ายแก๊สอาร์กอนและแก๊ส ในโตรเจนในกระบวนการเคลือบจะควบคุมด้วย mass flow controller ของ MKS type247D ดัง แสดงในรูปที่ 3.7





3.2.3 อุปกรณ์สำหรับทดสอบการกัดกร่อน

ก) เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) รุ่น PGSTAT 302H ของบริษัท ECO CHEMIE B.V. KANALWEG 29-G 3526 KM UTRECHT THE NETHERLANDS เป็นเครื่องใช้ ทดสอบการกัดกร่อนโดยควบคุมความต่างศักย์ให้กับระบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า general purpose electrochemical software (GPES) ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในเครื่อง โพเทนชิโอสแตท แล้วประมวลผลการทคสอบออกมาในรูปของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน หลังจากนั้น นำเส้นโค้งโพลาไรเซชันหาค่าสำคัญทางด้านการกัดกร่อน เช่น ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ค่าความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และค่าอัตราการกัดกร่อน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 เครื่องโพเทนชิโอสแตท

ง) อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) คือ ซิลเวอร์ต่อซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl, 3M KCl) ใช้สำหรับการวัดเทียบก่าศักย์ไฟฟ้ากับอิเล็กโทรดตัวอย่างดังแสดงใน รูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 อิเล็ก โทรคอ้างอิง (reference electrode)

ค) อิเล็กโทรดวัดกระแส (counter electrode) คือ แท่งกราไฟต์ (graphite) ใช้ สำหรับวัดเทียบค่ากระแสไฟฟ้ากับอิเล็กโทรดตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 อิเล็กโทรดวัดกระแส (counter electrode)

 จ) อิเล็กโทรดตัวอย่าง คือ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว
 ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวไทเทเนียมในไตรด์ ดัง แสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 อิเล็กโทรคตัวอย่าง (working electrode)

3.2.4 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบพื้นผิว

n) กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (optical microscope) รุ่น ZIESS AX10 ใช้ในการ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานก่อนและหลังกระบวนการอบชุบทางความร้อน ดังแสดงใน รูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (optical microscope)

 ง) กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ใช้ สำหรับตรวจสอบพื้นผิวหรือลักษณะ โครงสร้างของวัสดุและชั้นเคลือบ มีกำลังขยายตั้งแต่
 20 – 30,000 เท่า และสามารถวิเคราะห์ชั้นเคลือบในแนวลึกได้กว่า 300 เท่าของกล้องจุลทรรศน์ ปกติ ทำให้เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์ผิวที่ด้องการความละเอียด โดยทั่วไป SEM มักต่อพ่วงอยู่กับ การวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์ (EDX) ทั้งนี้เพื่อช่วยวิเคราะห์ชนิดของธาตุที่เป็นส่วนผสมของเนื้อวัสดุ หรือพื้นผิวบริเวณที่ถูกกัดกร่อน ดังแสดงในรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM)

ค) กล้องจุลทรรศน์ โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (photoelectron emission spectroscopy, PES) ซึ่งติดตั้ง ณ ระบบลำเลียงแสง 3.2a ของ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่อาศัย โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวตัวอย่างเพื่อทำให้เกิดภาพนอกจากนี้ยังสามารถเลือกวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างทางผลึกของวัตถุบนผิวของสารตัวอย่างได้อีกด้วย โดยใช้แสง ซินโครตรอนอยู่ในช่วงพลังงาน 40 -160 และ 220-1040 eV ใช้สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีและสำหรับการศึกษาโครงสร้างบริเวณพื้นผิวของวัสดุและชั้นเคลือบ โดยใช้ แสงซินโครตรอนอยู่ในช่วงพลังงาน 40 -160 และ 220-1040 eV ดังแสดงในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 กล้องจุลทรรศน์ โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรส โครปี

(photoelectron emission spectroscopy, PES)



3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนการทำวิจัยตามแผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย แสดงดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย

3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบผิว

ก) การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบผิว

นำเหล็กกล้ำ AISI 4140 ตัดให้ได้ขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร จากนั้นนำขึ้นงานอบชุบทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยการให้ความ ร้อนแก่ชิ้นงานที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำให้ชิ้นงานเย็นตัวอย่าง รวดเร็วด้วยน้ำมัน แล้วตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคก่อนและหลังกระบวนการอบชุบทางความร้อน โดยนำชิ้นงานไปทำการขัดผิวด้วยกระดาษเบอร์ 180 320 400 600 800 1000 และ 1200 และนำ ชิ้นงานไปขัดผิวแบบละเอียดด้วยผ้าสักหลาดโดยใช้ผงอะลูมินาขนาด 0.5 และ 0.03 ไม่ครอน ตามลำดับ จากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและเอทานอลตามลำดับ แล้วกัดขึ้นรอยบริเวณ ผิวชิ้นงานด้วยสารละลายกรดในตรีกความเข้มข้น 2 % โดยการจุ่มผิวหน้าชิ้นงานลงในสารละลาย เป็นเวลาประมาณ 8 วินาที ภายหลังการกัดผิวชิ้นงานในสารละลายแล้ว ทำการล้างชิ้นงานด้วยเอทานอล และเป๋าให้แห้ง จากนั้นตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง ได้ผล ดังแสดงในรูปที่ 3.16 และ 3.17 ตามลำดับ พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนอบชุบทางกวาม ร้อนโครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยเฟอร์ไรท์ (ferrite)และเพิร์ลไลท์ (pearlite) และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 หลังอบชุบทางกวามร้อนมิโครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยมาร์เทนไซต์ (martensite) และออสเตนไนท์เหลือค้าง (retained austenite)

ะ_{หาวัทยาลัยเทคโนโลยีสุรบ}ัง



รูปที่ 3.16 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนอบชุบทางความร้อน (กำลังขยาย 50 เท่า)



รูปที่ 3.17 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้ำ AISI 4140 หลังอบชุบทางความร้อน (กำลังขยาย 50 เท่า)

จากนั้นนำชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนและหลังอบชุบทางความร้อนไปวัด ความแข็งด้วยเกรื่องวัดความแข็งแบบร็อกเวล (สเกลซี) ก่าความแข็งที่ได้แสดงดังตารางที่ 3.2

ิตารางที่ 3.2 ค่าความแข็งของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
ก่อนการอบชุบทางความร้อน	30.0	29.3	30.5	30.0
หลังการอบชุบทางความร้อน	57.1	56.8	56.9	57.0

ง) การเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการเคลือบผิว

ภายหลังการอบชุบทางความร้อน นำชิ้นงานมาทำการเตรียมผิวชิ้นงานให้มี ความหยาบผิว (surface roughness) จำนวน 3 ค่า เพื่อศึกษาผลของความหยาบพิ้นผิววัสดุก่อนการ เคลือบผิวต่อคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ โดยใช้กระดาษทรายขัดชิ้นงาน ดังต่อไปนี้

ความหยาบที่ 1 ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 กรณีนี้เป็นผิวที่หยาบที่สุด

- ความหยาบที่ 2 ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 320 400 และ 600 ตามลำดับ กรณีนี้เป็นผิวที่ละเอียดปานกลาง

ความหยาบที่ 3 งัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 320 400 600 800 1000
 1200 และผงอะลูมินา ตามลำดับ กรณีนี้เป็นผิวที่ละเอียดที่สุด

หลังจากนั้นทำการล้างชิ้นงานด้วยน้ำสะอาด เอทานอลและเป่าให้แห้ง ตามลำดับ ทำการวัดกวามหยาบพื้นวัสดุของชิ้นงานทั้ง 3 สภาวะก่อนและภายหลังการเกลือบผิว ด้วยเกรื่องวัดกวามหยาบผิวแบบ a profile-meter (veeco) model จากการทดสอบวัดกวามหยาบผิว ของชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบผิว ชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ และชิ้นงานถูก เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ จะได้ผลของลักษณะภาพพื้นผิวแบบสามมิติและก่า กวามหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ดังแสดงในตารางที่ 3.3 3.4 และ 3.5 ตามลำดับ

		ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย
ชนงเน	ม เพพศษ ทะกาย เททผ	(นาโนเมตร)
ชิ้นงาน B1	3300 2500 - 1500 - 500 1500 1500 2500 3500 4500 4500 5500 5500 5500 5500	563.13
ชิ้นงาน B2	- 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000	200.12
ชิ้นงาน B3	- 1719 - 1719 - 1500 - 1000 - 500 500 500 500	31.14

ตารางที่ 3.3 ผลการวัดค่าความหยาบพื้นผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการเคลือบผิว

a 5		ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย
ชนงเน	ม เพพหษาชุกบุน เททฟ	(นาโนเมตร)
ชิ้นงาน C1	000 2097 - 1500 - 1000 - 500 - 500 - 500 - 1000 - 500 - 1000 - 1000 - 2000 - 22000 - 2319	294.32
ชิ้นงาน C2	- 500 500 	165.56
ชิ้นงาน C3	Contracting and a second se	30.92

ตารางที่ 3.4 ผลการวัดก่ากวามหยาบพื้นผิวของชิ้นงานหลังการเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์

* 		ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย
ชนงเน	าเพพหษากาม เททผ	(นาโนเมตร)
ชิ้นงาน T1	 5258 4500 3500 2500 1600 500 500 -500 -1500 -2500 -2500 -2500 	552.79
ชิ้นงาน T2	- 1000 1000 1100	202.40
ชิ้นงาน T3	5788 5000 - 4000 - 2000 - 1000 - 2000 - 3339	73.55

ตารางที่ 3.5 ผลการวัดค่าความหยาบพื้นผิวของชิ้นงานหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์

3.3.2 ขั้นตอนกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพ

กระบวนการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มี ตัวแปรในกระบวนการเคลือบดังแสดงในตารางที่ 3.6 และ 3.7 ตามลำดับ และมีรายละเอียดของ ขั้นตอนการเคลือบดังนี้

ก) ก่อนการเคลือบผิว นำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาด
 เพื่องจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่น ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผิววัสดุรองรับที่ได้
 มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวหน้าของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความ
 สะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) โดย
 ใช้อัลตราโซนิกส์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา
 5 นาที แล้วนำไปล้างต่อด้วยไอโซโพรพานอล (isopropanal) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำ
 วัสดุรองรับขึ้นด้วยคืมคืบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง

 ง) นำวัสดุรองรับที่เตรียมไว้วางบนแท่นวางวัสดุรองรับ แล้วปิดฝาภาชนะ สุญญากาศ

ค) ลดความคันภายในภาชนะสุญญากาศเท่ากับ 5 x 10⁻⁵ มิลลิบาร์ กำหนดเป็นค่า
 ความคันพื้นของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความคันที่อ่านได้

 ง) ทำความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ pre-sputtering เป็น เวลา 3 นาที

 งั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอนและแก๊ส ในโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทคลอง

จ่ายศักย์ไฟฟ้าลบให้แก่กาโทด จนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่)
 เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้กาโทดและกระแสกาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเกลือบ
 ฟิล์มบาง โดยเปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเกลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ
 พร้อมทั้งบันทึกผลก่ากวามต่างศักย์ไฟฟ้า ก่ากระแสไฟฟ้า และความดันรวมที่เกิดขึ้นขณะเริ่ม
 เกลือบฟิล์ม และทำการเกลือบฟิล์มตามเวลาที่กำหนด

ช) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน
 ปิดแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสุญญากาศเพื่อนำวัสดุรองรับออก

ตารางที่ 3.6 ตัวแปรในการเกลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ (CrN) ในกระบวนการเกลือบผิว แบบไอทางกายภาพ

ตัวแปร	ค่ากำหนด	
เป้าสารเคลือบ	โครเมียม	
ความดันฐาน (มิลลิบาร์)	5.0x10 ⁻³	
ความคันขณะเคลือบ (มิลลิบาร์)	3.5×10^{-5}	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	350	
กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)	800	
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสคุรองรับ (เซนติเมตร)	15	
ความต่างศักย์ใบแอส (โวลต์)	-456	
เวลาในการเคลือบ (นาที)	40	
อุณหภูมิขณะเกลือบผิว	อุณหภูมิห้อง	
ความหนาของฟิล์ม (นาโนเมตร)	914	

ตารางที่ 3.7 ตัวแปรในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ (TiN) ในกระบวนการเคลือบผิว แบบไอทางกายภาพ

ตัวแปร	ค่ากำหนด
เป้าสารเคลือบ (Target)	ไทเทเนียม
ความดันฐาน (มิลลิบาร์)	5.0×10^{-3}
ความคันขณะเคลือบ (มิลลิบาร์)	$2.5 \text{x} 10^{-5}$
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	350
กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)	800
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสคุรองรับ (เซนติเมตร)	10
ความต่างศักย์ไบแอส (โวลต์)	- 369
เวลาในการเกลือบ (นาที)	60
อุณหภูมิขณะเคลือบผิว	อุณหภูมิห้อง
ความหนาของฟิล์ม (นาโนเมตร)	1200

3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวก่อนทดสอบการกัดกร่อน

ก) นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพไปตรวจวัดโครงสร้างผลึก ด้วยเทกนิก X-ray diffraction (XRD)

 บ) นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพไปตรวจสอบขนาดเกรน และความหนาของชั้นฟิล์มด้วยเทคนิค atomic force microscopy (AFM)

 ค) นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพไปตรวจสอบโครงสร้าง จุลภาคตามแนวภาคตัดขวางด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM)

3.3.4 ขั้นตอนการทดสอบการกัดกร่อน

นำชิ้นงานที่ยังไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมไนไตรค์ และ ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรค์ไปทดสอบการกัดกร่อนด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (potentiostat) ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 % โดยน้ำหนักที่มีค่าความเป็นกรด-ค่าง (pH) เท่ากับ 2 7 และ 10 โดยมีการควบคุมตัวแปรในการทดลอง ได้แก่

เวลาที่ใช้ในการที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศอิ่มตัวในสารละลายเท่ากับ 5 นาที

อัตราการแสกนเท่ากับ 1 มิลลิโวลต์ต่อวินาที

- อุณหภูมิที่ใช้ในการทคลองเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส

ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรค์เท่ากับ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

- เวลาที่ใช้ในการแช่ชิ้นงานก่อนการสแกนเท่ากับ 45 นาที

ขั้นตอนในการทดสอบการกัดกร่อน มีรายละเอียดดังนี้

ก) เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 3.5% โดยน้ำหนัก ปริมาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อการทดลอง 1 ครั้ง เมื่อใช้ทดสอบแล้วเปลี่ยนสารละลายใหม่ทุกครั้ง

 ง) หลังจากเตรียมสารละลายเรียบร้อยแล้ว ทำการปรับค่า pH ของสารละลายให้ มีค่าเท่ากับ 2 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCI) ความเข้มข้น 3 โมลาร์ประมาณ 6 หยด และทำการปรับ ค่าพีเอช ของสารละลายให้มีค่าเท่ากับ 7 และ 10 โดยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ประมาณ 5-6 หยด ต่อสารละลาย 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ค) ใช้เครื่องพ่นอากาศพ่นอากาศลงในสารละลายเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้
 ออกซิเจนอิ่มตัวในสารละลาย

 หลังจากนั้นทำการติดตั้งเซลล์ทดสอบการกัดกร่อน เริ่มต้นจากการติดตั้ง ชิ้นงานทดสอบเข้ากับเซลล์ใส่สารละลายโดยให้ชิ้นงานสัมผัสกับสารละลายเป็นพื้นที่ 0.85 ตาราง
เซนติเมตร ชิ้นงานทคสอบจะเป็นอิเล็กโทรคตัวอย่าง (working electrode) ต่อเข้ากับอิเล็กโทรค อ้างอิง (reference electrode) ที่เป็น Ag/AgCl และใช้แท่งกราไฟต์เป็นอิเล็กโทรคกระแส (counter electrode) จุ่มลงในสารละลาย นอกจากนี้ทำการพ่นอากาศลงในสารละลายตลอคช่วงการทำการ ทคลอง ต่อขั้วอิเล็กโทรคอ้างอิง (reference electrode) และอิเล็กโทรคกระแส (counter electrode) เข้ากับเครื่องโพเทนชิโอสเตท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล คังแสคงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 แผนภาพการต่อเซลล์ทคสอบการกัดกร่อน

จ) เปิดเครื่อง potentiostat และคอมพิวเตอร์ประมวลผล โดยใช้โปรแกรม a μautolab software (general purpose electrochemical, GPES) ในการทดสอบ เริ่มการทดสอบโดย ขั้นตอนแรกเป็นการวัดค่าศักย์ฟ้าวงจรเปิด (open circuit potential, OCP) และต่อด้วยขั้นตอนที่สอง เป็นการวัดเส้นโพลาไรเซชั่น ทำการป้อนศักย์ไฟฟ้าด้วยอัตราการป้อนเท่ากับ 1 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ผลที่ได้จะเป็นลักษณะการวัดเส้นโพราไรเซชั่น (polarizatiom) ซึ่งจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการ กัดกร่อนและค่าสำคัญทางการกัดกร่อนของชิ้นงานทดสอบ โดยมีเงื่อนไขและจำนวนของชิ้นงานที่ ใม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโกรเมียมไนไตรด์และไทเทเนียมในไตรด์ในการทดสอบ การกัดกร่อน (ในงานวิจัยจะทำการทดสอบการกัดกร่อนแต่ละสภาวะจำนวน 2 ชิ้นแล้วนำค่าเฉลี่ย ไปทำการวิเคราะห์ผล) ดังแสดงในตารางที่ 3.8 3.9 และ 3.10 ตามลำดับ

ความหยาบผิวของวัสดุ	สัญลักษณ์ชิ้นงาน	າ	จำนวนชิ้นงาน		
		พีเอช 2	พีเอช 7	พีเอช 10	ทั้งหมด
ความหยาบที่ 1	B1	2	2	2	6
ความหยาบที่ 2	B2	2	2	2	6
ความหยาบที่ 3	В3	2	2	2	6

ตารางที่ 3.8 จำนวนชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวและสภาวะที่ใช้ทคสอบการกัดกร่อน

ตารางที่ 3.9 จำนวนชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และสภาวะที่ใช้ทดสอบการกัดกร่อน

ความหยาบผิวของวัสดุ	ຮັບເຮັດແມ່ນຄື	ຳໍ	จำนวนชิ้นงาน		
	បហើបគេរោលករាក	พีเอช 2	พีเอช 7	พีเอช 10	ทั้งหมด
ความหยาบที่ 1	C1	2	2	2	6
ความหยาบที่ 2	C2	2	2	2	6
ความหยาบที่ 3	C3	2	2	2	6

ตารางที่ 3.10 จำนวนชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไนไตรด์และสภาวะที่ใช้ทคสอบการกัดกร่อน

ความหยาบผิวของวัสดุ	สัญลักษณ์ชิ้นงาน	ຈໍ	จำนวนชิ้นงาน		
		พีเอช 2	พีเอช 7	พีเอช 10	ทั้งหมด
ความหยาบที่ 1	715 T1	2	2	2	6
ความหยาบที่ 2	_{T2} าลัยเก	กโนโ2ยี จุ	2	2	6
ความหยาบที่ 3	Т3	2	2	2	6

ฉ) แปลความหมายของเส้นกราฟโพลาไรเซชั่นที่ได้จากการทดลองด้วยการ
 วิเคราะห์แบบ tafel เพื่อหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{cor}) ค่าความ
 หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, I_{cor}) และค่าอัตราการกัดกร่อน
 (corrosion rate, R_{mmy})

3.3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวหลังทดสอบการกัดกร่อน

ภายหลังการทดสอบการกัดกร่อน ทำการตรวจสอบพื้นผิว บริเวณที่ถูกกัดกร่อน ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวและผ่านการเคลือบผิวด้วยโครเมียมไตรด์และ ไทเทเนียมไตรด์ก่อนการตรวจสอบทำการล้างชิ้นงานด้วยอะซิโตนและเอทานอลเพื่อกำจัดคราบ ไขมันออก โดยเฉพาะสำหรับกรณีการตรวจสอบด้วยเทคนิก XPS นอกจากทำความสะอาคโดยการ ล้างด้วยด้วยอะซิโตนและเอทานอลแล้ว จำเป็นจะต้องมีการทำกวามสะอาดด้วยเครื่องอุลตราโซนิก เพิ่มเติมอีกด้วย เนื่องจากในระบบการตรวจสอบนั้นเป็นระบบที่มีความเป็นสุญญากาศสูง จึง ต้องการชิ้นงานที่มีความสะอาดสูง หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปทำการตรวจสอบด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้

ก) นำชิ้นงานภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนทำการตรวจสอบพื้นผิว (surface)
 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM) ร่วมด้วยเทคนิค EDX
 ง) นำชิ้นงานภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนทำการตรวจสอบผสมทางเคมี
 (chemical composition) ของบริเวณที่ถูกกัดกร่อนของชิ้นงานด้วยเทคนิค X-ray photoelectron
 spectroscopy (XPS)



บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน

4.1.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)

ฐปที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ เคลือบบนเหล็กกล้ำ AISI 4140 ด้วยกระบวนการเคลือบไอทางกายภาพที่มีการควบคุมอัตราการ ใหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรเจนที่แตกต่างกัน ได้แก่ อัตราการไหลมวลของแก๊ส อาร์กอนต่อแก๊ส ใน ใตร โจนเท่ากับ 9:9 9:7.5 และ 9:6 จากผลการวิเคราะห์พบการปรากฎของ ้สารประกอบโครเมียมในไตรด์ที่ทกอัตราการใหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สในไตรโจน โคย สารประกอบโครเมียมในไตรด์ที่ปรากฏมีโครงสร้างผลึกที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (111) ที่มม 37.38 องศา ระนาบ (220) ที่มม 63.20 องศา และระนาบ (311) ที่มม 75.30 องศา แต่ อย่างไรก็ตามพบว่าที่อัตราการไหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรโจนเท่ากับ 9:6 แสดงให้ เห็นการปรากฎของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับที่เงื่อนไขอื่นๆ และ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (111) มีก่ากวามเข้มของพลังงานสูงที่สุด ้ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอัตราการใหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรโจนมี ้ผลต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และในงานวิจัยนี้ฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ที่ ้ได้มีโครงสร้างผลึกที่มีการจัดเรียงอะตอมในระนาบ (111) เป็นส่วนใหญ่ จากการวิเคราะห์ผล ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ (Novakovic, M., Popovic, M., Bibic, N., 2010; Feng, H.P., Cheng, H.H., Jung, K.L., Yih H.S., 2003; Hanand, S., Lin, J.H., Tsai, S.H., Chung, S.C., Wamg, D.Y., Lu, F.H., Shih, H.C., 2000)



รูปที่ 4.1 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์

4.1.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM)

รูปที่ 4.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะของการสแกนกับความหนาของ ชั้นฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ในการทคลองจะทำการสแกน ทั้งหมด 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะสแกนเป็นระยะเท่ากับ 10 ไมโครเมตร แล้วหาก่าเฉลี่ยของความหนา ของชั้นฟิล์ม จากการวิเคราะห์พบว่าฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มีความหนาเฉลี่ยประมาณ 0.9 ไมครอนเมตร

รูปที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่เคลือบ บนเหล็กกล้ำ AISI 4140ในลักษณะภาพสองมิติและสามมิติด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม พบว่าเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มีลักษณะกลม มีการจัดเรียงตัวที่หนาแน่นและสม่ำเสมอ และนอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์กำนวณหาขนาดเกรนเฉลี่ยของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม โดยเลือกบริเวณที่จะวัดขนาดเกรนแล้วลากเส้นทั้งหมด 3 เส้น เป็นระยะ 1 ไมโครเมตร พร้อมกับใช้โปรแกรมในการกำนวณเพื่อหาก่าเฉลี่ย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 พบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยของฟิล์มบางโครเมียมในใตรค์มีค่าเท่ากับ 14.6 นาโนเมตร ซึ่งในงานวิจัยนี้ จะมีการควบคุมค่าความหนาของฟิล์มบางโครเมียมในใตรค์ให้คงที่ตลอดการทดลอง และเมื่อ พิจารณาบริเวณพื้นสีดำในรูปที่ 4.3 ซึ่งมีลักษณะเป็นร่องลึกปรากฎในเนื้อฟิล์ม ร่องลึกที่ปรากฎใน เนื้อฟิล์มนี้คือ ข้อบกพร่องชนิดหนึ่งที่เรียกว่า รูพรุน โดยรูพรุนที่เกิดขึ้นในเนื้อฟิล์มนี้อาจจะส่งผล ต่อคุณสมบัติการด้านทานการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ (Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G., 2002)



รูปที่ 4.2 การหาค่าความหนาของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์



รูปที่ 4.3 ลักษณะเกรนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์



รูปที่ 4.4 การหาขนาดเกรนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์

 4.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM)

รูปที่ 4.5 แสดงโครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 พบว่าฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์มีลักษณะเกรนเป็นแท่ง (columnar) ลักษณะเกรนมีการจัดเรียงตัวที่หนาแน่น และมีปริมาณรูพรุนบนพื้นผิวน้อย (สามารถ พิจารณาควบคู่กับผลทางด้านกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม)



รูปที่ 4.5 โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140

- 4.2 คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน
 - 4.2.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า
 AISI 4140 ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)

รูปที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่ เคลือบบนเหล็กกล้ำ AISI 4140 ด้วยกระบวนการเคลือบไอทางกายภาพที่มีการควบคุมอัตราการ ไหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สในโตรเจนที่แตกต่างกัน ได้แก่ อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน ต่อแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 15:2 15:1.5 และ 15:1 จากการวิเคราะห์พบการปรากฏของสารประกอบ ไทเทเนียมในไตรด์ที่ทุกอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สในโตรเจน โดยสารประกอบ ไทเทเนียมในไตรด์ที่ปรากฏเป็นโครงสร้างผลึกที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (111) ที่มุม 36.68 องศา ระนาบ (200) ที่มุม 42.06 องศา ระนาบ (220) ที่มุม 61.70 องศา และระนาบ (331) ที่มุม 73.78 องศา แต่อย่างไรก็ตามพบว่าที่ก่าอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 15:2 แสดงให้เห็นการปรากฏของสารประกอบไทเทเนียมในไตรด์ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับที่ เงื่อนไขอื่นๆ และนอกจากนี้ยังพบว่าการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (111) มีก่ากวามเข้มของ พลังงานสูงที่สุด ดังนั้นจากผลการวิเกราะห์แสดงให้เห็นว่าอัตราการไหลมวลของแก๊สอาร์กอนต่อ แก๊สไนไตรโจนมีผลต่อโกรงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ และในงานวิจัยนี้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมในไตรด์ที่ได้จากกระบวนการเกลือบไอทางกายภาพมีโกรงสร้างผลึกที่มีการจัดเรียงตัว ของอะตอมในระนาบ (111) เป็นส่วนใหญ่ จากการวิเกราะห์ผลดังกล่าวสอดกล้องกับรายงานวิจัย ของ (Fengqun, L., Zhiming, Y., 2001; Franco, C.V., Fontana, L.C., Bechi, D., Martinelli, A.E., Muzart, J.L.R., 1998)



รูปที่ 4.6 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์

4.2.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM)

รูปที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์หาก่ากวามหนาของชั้นฟิล์มบางไทเทเนียม ในไตรค์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ในการทคลองจะทำการสแกนทั้งหมด 3 ครั้ง ในแต่ ละครั้งจะสแกนเป็นระยะเท่ากับ 10 ใมโครเมตรเช่นเดียวกับกรณีฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ แล้ว หาค่าเฉลี่ยของความหนาของชั้นฟิล์ม จากการวิเคราะห์พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์มีความ หนาเฉลี่ยประมาณ 1.2 ใมโครเมตร ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมีการควบคุมค่าความหนาของฟิล์มบาง ไทเทเนียมในไตรค์ให้กงที่ตลอดการทดลอง



รูปที่ 4.7 การหาค่าความหนาของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์

รูปที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะเกรนของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่ เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140ในลักษณะภาพสองมิติและสามมิติด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรง อะตอม พบว่าเกรนของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีลักษณะเป็นแท่งยาว (columnar) และมีการ จัดเรียงตัวที่ไม่สม่ำเสมอ และพบบริเวณพื้นสีดำซึ่งมีลักษณะเป็นร่องลึกปรากฏในเนื้อฟิล์ม ซึ่งร่อง ลึกที่ปรากฏในเนื้อฟิล์มนี้อาจเป็นข้อบกพร่องของเนื้อฟิล์ม เช่น รูพรุนหรือรูโพรง เป็นต้น เช่นเดียวกับในฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ แต่พบว่าข้อบกพร่องในฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์มี ต่อกุณสมบัติการด้านทานการกัดกร่อนของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ (Rudenja, S., Kulu, P., Tallimets E., Mikli, V., Straede C.A.,1999)



รูปที่ 4.8 ลักษณะเกรนของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140

4.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด (scanning electron microscope, SEM)

รูปที่ 4.9 แสดงโครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนียม ในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีลักษณะเกรนเป็น แท่ง (columnar) เช่นเดียวกันกับกรณีฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ แต่เกรนมีลักษณะการจัดเรียงตัวที่ ไม่หนาแน่น มีความไม่สม่ำเสมอ และมีปริมาณรูพรุนบนพื้นผิวมากกว่าฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ (สามารถพิจารณาควบคู่กับผลทางด้านกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม)



รูปที่ 4.9 โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140

4.3 พฤติกรรมการกัดกร่อน

้จากผลการทคลองพฤติกรรมการกัคกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ผิว (ชิ้นงาน B1 B2 และ B3) ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรค์ (ชิ้นงาน C1 C2 และ C3) และชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวค้วยฟิล์มบาง ใทเทเนียมในไตรด์ (ชิ้นงาน T1 T2 และ T3) ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 27 และ 10 จะได้ผลการทดลองแสดงดังตัวอย่างเส้นโค้งโพลาไรเซชัน ดังแสดง ในรูปที่ 4.10 ถึง 4.18 ตามลำคับ พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากการทคลองจะอยู่ในช่วงระหว่าง –1000 ถึง 200 มิถลิโวลต์ และค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 10⁻⁹ ถึง 10⁻² แอมแปร์ต่อ ตารางเซนติเมตร และพบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 มีการ เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์บน 4140 นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานทั้งหมดมีการ ผิวชิ้นงาน AISI เปลี่ยนแปลงตามค่าพีเอชของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบและความหยาบของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการเกลือบผิวอย่างชัดเจน จากเส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานทั้งหมดนี้สามารถ นำมาหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{cor}) ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการ กัดกร่อน (corrosion current density, I corr) และสามารถนำค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการ กัดกร่อนที่ได้ไปคำนวณเพื่อหาก่าอัตราการกัดกร่อน (corrosion rate, R_mmy) ได้ผลดังแสดงในตาราง ที่ 4.1 โดยค่าที่แสดงในตารางที่ 4.1 เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่าง การหาค่าต่างๆเหล่านี้ และข้อมูลทั้งหมดแสดงภาคผนวก ก และ ข ตามลำคับ)

^{/ยา}ลัยเทคโนโลย^{ัอ}



รูปที่ 4.10 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ 4.11 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวใน สารละลายโซเคียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ 4.12 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวใน สารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ 4.13 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2







รูปที่ 4.15 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ 4.16 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ 4.17 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ 4.18 เส้นโค้งโพลาไรเซชั่นของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10



ชิ้นงาน	พีเอช 2		พีเอช 7			พีเอช 10			
	E _{corr}	I _{corr}	R _{mmy}	E _{corr}	I _{corr}	R _{mmy}	E _{corr}	I _{corr}	R _{mmy}
B1	-605	11.23	0.1318	-535	8.01	0.0941	-582	0.72	0.0084
B2	-639	5.38	0.0631	-535.5	4.52	0.0531	-595	0.63	0.0074
В3	-570	5.42	0.0636	-598.5	0.59	0.0069	-559	0.46	0.0054
C1	-534.5	7.47	0.0220	-526.5	0.75	0.0022	-465.5	0.72	0.0021
C2	-534.5	2.61	0.0077	-492	0.58	0.0017	-421.5	0.57	0.0017
C3	-536	0.92	0.0027	-411.5	0.42	0.0012	-419.5	0.25	0.0007
T1	-536	4.10	0.0129	-468.5	0.62	0.0019	-469.5	0.66	0.0021
T2	-560.5	4.07	0.0128	-456	0.53	0.0017	-463.5	0.69	0.0019
Т3	-502	1.25	0.0039	-426	0.21	0.0007	-433	0.66	0.0020

ตารางที่ 4.1 ค่าที่ได้จากเส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมไนไตรด์และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีค่าพีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10

หมายเหตุ

E_{corr} ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (มิลลิโวลต์)

I_{con} ค่าความหนานแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (ไมโครแอมป์/ตารางเซนติเมตร)

R_{mmv} ค่าอัตราการกัดกร่อน (มิลลิเมตร/ปี)

เพื่ออธิบายถึงผลของการศึกษาการเคลือบผิวเหล็กกล้ำ AISI 4140 ด้วยฟิล์มบางที่แตกต่าง ชนิดกัน คือ โครเมียมในไตรค์และไทเทเนียมในไตรค์ ตลอดจนก่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ สารละลายที่ใช้ในการทดสอบ และผลของความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการเคลือบ ผิวที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการทดลองดังแสดงในหัวข้อต่อไปนี้

4.3.1 ผลของการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์บน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน

รูปที่ 4.19 ถึง 4.21 แสดงก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ในสารละลายโซเดียม กลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ พบว่าก่าศักย์ไฟฟ้า การกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ โดยชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์และซิ้นงานเหล็กกล้าที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไกเทเนียมในไตรด์มีก่า สักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงกว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีก่า ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงกว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์ม บางไทเทเนียมในไตรด์น้น แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานมีเสถียรภาพและมีความต้านทานการกัดกร่อน เพิ่มมากขึ้น

ุ ^ทยาลัยเทคโนโลยีส^{ุร}



รูปที่ 4.19 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ 4.20 ก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ 4.21 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10

รูปที่ 4.22 ถึง 4.24 แสดงค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเคียม คลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10 พบว่าก่าอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้า AISI 4140 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์และฟิล์ม บางไทเทเนียมในไตรด์ โดยก่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีก่าน้อย กว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่ก่าความหยาบผิวและก่าพีเอชเดียวกัน

จากผลของค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิว (Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G., 2002; Darja, K.M., Peter P., Miha, C., Marijan M., 2004; Feng, H.P., Cheng, H.H., Jung, K.L., Yih H.S., 2003; Chen J.Y.,Yu G.P., Huang J.H., 2000; You, H. –xia., Xu, H.-bin., Zhang, Y., Zheng, S.-li., Gao, Y.-ying., 2008; Rudenja, S., Kulu, P., Tallimets E., Mikli, V., Straede C.A., 1999.)



รูปที่ 4.22 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ 4.23 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ 4.24 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหลีกกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10

การที่ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และชิ้นงานที่ถูกเคลือบ ผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์มีความสามารถด้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่ถูก เคลือบผิวนั้น อธิบายได้ว่าเป็นผลจากฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ที่ เคลือบบนผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 มีส่วนช่วยในการต้านทานการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นบนผิว เหล็กกล้า AISI 4140 เนื่องจากในโตรเจนอะตอมในฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และฟิล์มบาง ไทเทเนียมไนไตรค์เกิดการละลายระหว่างการทดสอบการกัดกร่อน และปรากฎเป็นไนโตรเจนใน รูปประจุลบ (N⁻) บริเวณผิวชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยในการผลักอะตอมของคลอไรด์ (CI) ที่อยู่ใน สารละลายที่จะเข้ามาทำลายผิวชิ้นงานให้ออกจากบริเวณผิวชิ้นงาน ขณะเดียวกัน (N) ที่ละลายใน สารละลายจะรวมตัวกับไฮโครเจนไอออน (H⁺) เกิดเป็นแอมโมเนีย (NH⁺₄) ดังสมการที่ 4.1

 $[N] + 4H^{+} + 3e^{-} = NH_{4}^{+}$ (4.1)

จากสมการที่ 4.1 สารประกอบแอมโมเนีย (NH⁺₄) ที่เกิดขึ้นจะทำให้ค่าพีเอชของ สารละลายเพิ่มขึ้นทำให้การกัดกร่อนที่เกิดจากสารละลายลดน้อยลง (Chyou S. D., Shih H. C., 1991; Grabke H. J., 1996; Medina-Flores, A., Arganis, C., Santiago, P., Oseguera., 2004) ซึ่ง สอดกล้องกับการวัดก่าพีเอชภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 2 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยก่าพีเอชของสารละลายภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม บางโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์มีก่าโดยเฉลี่ย เท่ากับ 2.15 และ 2.10 ตามลำดับ ส่วนที่ก่าพีเอช 7 และ 10 ภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานทั้งหมดแสดงใน ภาคผนวก ก)

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิว ้ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ พบว่าค่า ้ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์มีแนวโน้มมีก่าสูง กว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวค้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ และในขณะเคียวกันเมื่อพิจารณา เปรียบเทียบค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และ ้ชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ พบว่าก่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูก เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์มีค่าน้อยกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ้ไทเทเนียมไนไตรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมไนไตรค์มีกวาม ต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (Ibrahim, M.A.M., Korablov S.F., Yoshimura, M. 2002; Liu, C., Bi, O., Matthews, A. 2001) และแสดงให้ ้เห็นว่าแม้ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์จะมีความหนาน้อยกว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ก็ยังคงมี คุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่า (ในงานวิจัยนี้ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์หนา 0.9 ใมครอนเมตร และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์หนา 1.2 ไมครอนเมตร) ผลดังกล่าวอาจเนื่องจาก ้ฟิล์มไทเทเนียมในไตรค์เป็นฟิล์มที่มีโครงสร้างเป็นลักษณะแท่ง (columnar) และมีข้อบกพร่อง เช่น ฐพรุน ในเนื้อฟิล์มมาก ทำให้สารละลายมีโอกาสที่จะแพร่เข้าสู่ชั้นฟิล์มและทำปฏิกิริยาการ กัดกร่อนชั้นฟิล์มได้ง่ายกว่าฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่มีโครงสร้างเป็นลักษณะแท่ง (columnar) เช่นเดียวกัน แต่มีความหนาแน่น มีความสม่ำเสมอ และปริมาณรูพรุนที่น้อยกว่าฟิล์มไทเทเนียมไน ์ ไตรค์ ดังแสดงในผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวด้วย AFM และการวิเคราะห์โครงสร้างจลภาคตามแนว ภาคตัดขวางด้วย SEM (Liu, C., Leyland, A., Lyon, S., Matthews, A. 2001; William Grips, V.K., Harish, C.B., Ezhil Selvi, V., Kalavati, Rajam K.S. 2006)

4.3.2 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน

รูปที่ 4.25 ถึง 4.27 แสดงค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าพีเอชของสารละลาย ส่วนค่า ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทรเมียม ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มี แนวโน้มสูงขึ้นเมื่อค่าพีเอชของสารละลายเพิ่มมากขึ้น ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่เพิ่มสูงขึ้นแสดงให้ เห็นว่าชิ้นงานมีเสถียรภาพและความสามารถต้านทานการกัดกร่อนเพิ่มมากขึ้น



รูปที่ 4.25 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.26 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบ ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.27 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบ ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10

รูปที่ 4.28 ถึง 4.30 แสดงผลของค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลาย โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 พบว่าเมื่อค่าพีเอชของ สารละลายเพิ่มขึ้น ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง โดยที่ค่าพีเอช 2 ชิ้นงานจะมีค่าอัตราการกัดกร่อนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับที่ค่าพีเอช 7 และ 10 ตามลำดับ



รูปที่ 4.28 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.29 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบ ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.30 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบ ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10

้งากผลของค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานทั้งหมด ้จึงกล่าวได้ว่าก่าพีเอชของสารละลายที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชิ้นงานมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี ้ขึ้น การที่พฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานมีค่าแตกต่างกันในละค่าพีเอชนั้น อาจเนื่องมาจากผล ้งองไอออนที่ปรากฏในสารละลายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานในแต่ละค่าพีเอช ใด้ทำการปรับค่าพีเอชโดยใช้กรคไฮโครคลอริก (HCl) ทำให้มีปริมาณ กล่าวคือ ที่ค่าพีเอช 2 ้คลอไรค์ไอออน (CI) ในสารละลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง CI จะเข้าไปทำลายเนื้อวัสคไค้มากยิ่งขึ้น และ เมื่อผิวของวัสดุสัมผัสกับสารละลาย Cl⁻ในสารละลายจะทำปฏิกิริยากับเหล็ก (Fe²⁺) ในเนื้อ เหล็กกล้า AISI 4140 เกิดเป็นสารประกอบเฟอร์ริกกลอไรด์ (Fe²⁺Cl²) ดังสมการที่ 4.2 หลังจากนั้น Fe²⁺Cl₂ จะปฏิกิริยากับน้ำ (H₂O) เกิดเป็นสารประกอบกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และสารประกอบ เฟอร์รัสไฮดรอกไซด์ (Fe(OH),) ดังสมการที่ 4.3 สำหรับชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ้โครเมียมในไตรค์และชิ้นงานที่ถกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์นั้น ผิวของฟิล์มบาง ้โครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์จะถกกัดกร่อนโดย Cl นบริเวณข้อบกพร่อง ของฟิล์ม เช่น รูพรุน และรอยแตก เป็นต้น (Cunha, L., Andritschky M., Rebouta L., Pischow., ี่ 1999) นอกจากนี้ยังมีการเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของไฮโครเจนไอออน (H⁺) ที่มีอยุ่มากในสารละลายที่ ้มีความเป็นกรคสูงและเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าพีเอชโคยใช้กรคไฮโครคลอริก (HCl) โคย (H⁺) เกิค การรวมตัวกับ e เป็นก๊าซไฮโดรเจนคังสมการที่ 4.4 และก๊าซไฮโครเจนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้จะ เกาะอยู่ตามผิวของวัสดุ และฟิล์มบางเกิดแรงดันทำลายผิวของวัสดุและผิวของฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ และไทเทเนียมในไตรด์ให้เกิดความเสียหายได้

$$\operatorname{Fe}^{2^{+}}(\operatorname{aq}) + \operatorname{Cl}_{2}(\operatorname{aq}) \longrightarrow \operatorname{Fe}^{2^{+}}\operatorname{Cl}_{2}(\operatorname{aq})$$

$$(4.2)$$

$$\operatorname{Fe}^{2+}\operatorname{Cl}_{2}^{-}(\operatorname{aq}) + 2\operatorname{H}_{2}\operatorname{O}(\operatorname{aq}) \longrightarrow \operatorname{Fe}(\operatorname{OH})_{2}(\operatorname{s}) + 2\operatorname{H}^{+}\operatorname{Cl}^{-}(\operatorname{aq})$$

$$(4.3)$$

$$2H^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow H_2(g)$$
(4.4)

สำหรับในกรณีชิ้นงานไม่ถูกเคลือบผิวที่เกิดการกัดกร่อนในสารละลายที่มีค่า พีเอช 7 และ 10 นั้น ปฏิกิริยาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน (ภายในน้ำที่มีสภาพเป็นกลางและด่าง) ทำปฏิกิริยาแล้วแตกตัวให้ OH-ดังสมการที่ 4.5 และ OH ที่มาจากการแตกตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของสารละลายทำ ปฏิกิริยากับ Fe²⁺ ในเนื้อเหล็กกล้า AISI 4140 ที่สัมผัสกับสารละลายเกิดเป็นสารประกอบ Fe(OH)₂ ดังสมการที่ 4.6 สารประกอบ Fe(OH)₂นี้เป็นฟิล์มที่สามารถช่วยในการต้านทานการกัดกร่อนได้ (AHMAD, Z., 2006) แต่สารประกอบ Fe(OH)₂นี้ยังสามารถเกิดการออกซิเดชันต่อไปได้อย่าง รวดเร็วด้วยออกซิเจนที่มีอยู่ในระบบและน้ำเกิดเป็นสารประกอบเฟอร์ริกไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)₃) ดังสมการที่ 4.7 ซึ่งสารประกอบ Fe(OH)₃ เป็นสารประกอบที่ไม่มีเสถียรภาพจะเกิดปฏิกิริยาต่อไป กลายเป็นสารประกอบใหม่ คือ สารประกอบไฮเดรทเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe₂O₃) หรือเรียกกันอย่าง ทั่วไปว่า สนิมเหล็กสีแดง

$$O_2(s) + 2H_2O(aq) + 4e \rightarrow 4OH(aq)$$
 (4.5)

$$\operatorname{Fe}^{2^{+}}(\operatorname{aq}) + 2\operatorname{OH}^{-}(\operatorname{aq}) \longrightarrow 2\operatorname{Fe}(\operatorname{OH})_{2}(\operatorname{s})$$
 (4.6)

$$4Fe(OH)_{2}(s) + O_{2}(aq) + 2H_{2}O(aq) \rightarrow 4Fe(OH)_{3}(s)$$

$$(4.7)$$

้ส่วนในกรณีของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และชิ้นงาน ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่ก่าพีเอช 7 และ 10 นั้น กระบวนการกัดกร่อนที่ ้เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน เนื่องด้วยชนิดของฟิล์มบางที่เคลือบบนผิววัสดแตกต่างกัน โดยการกัดกร่อน ้ที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์นั้นเกิดขึ้นจากฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์ทำปฏิกิริยากับน้ำ (H,O) เกิดเป็นสารประกอบโครเมียม (II) ออกไซค์ (CrO) คัง ้สมการที่ 4.8 หรือทำปฏิกิริยากับน้ำ (H₂O) เกิดเป็นสารประกอบ โครเมียม (III) ออกไซด์ (Cr₂O₂) ดัง สมการที่ 4.9 ซึ่งสารประกอบทั้งสองชนิคนี้เป็นฟิล์มที่มีเสถียรภาพและคุณสมบัติในการต้านทาน การกัดกร่อนใด้ดี (Cunha, L., Andritschky, M., Rebouta, L., Silva, R., 1997; Cunha, L., Andritschky M., Rebouta L., Pischow., 1999; Fenker, M., Balzer M., Kappl H., 2006) นอกจากนี้ ้โครเมียม (Cr)ในฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์อาจทำปฏิกิริยากับ OH เกิดเป็นสารประกอบ ์ โครเมียมไฮครอกไซค์ (Cr(OH),) อีกด้วย ดังสมการที่ 4.10 โคยสารประกอบ Cr(OH), นี้เป็นฟิล์มที่ ้มีความสามารถต้ำนทานการกัดกร่อนได้ แต่เนื่องจากเป็นฟิล์มที่ไม่มีเสถียรภาพ จึงมีความสามารถ ต้านทานการกัดกร่อนได้น้อยกว่าฟิล์ม Cr₂O₂ (You, H. –xia., Xu, H.-bin., Zhang, Y., Zheng, S.-li., Gao, Y.-ying., 2010) ในขณะเคียวกันในกรณีของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม ในไตรค์นั้นที่ค่าพีเอช 7 และ 10 นั้น กระบวนการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นเกิดจากฟิล์มบางไทเทเนียม ในไตรค์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน(O,) ที่มีอยู่ในสารละลายหรือน้ำ (H,O) เกิดเป็นสารประกอบ

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ดังสมการที่ 4.11 และ 4.12 หรือฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์อาจทำ ปฏิกิริยากับน้ำ(H₂O) เกิดเป็นสารประกอบไทเทเนียมไฮดรอกไซด์ (Ti(OH)₃) ดังสมการที่ 4.13 ซึ่ง สารประกอบ TiO₂ และ Ti(OH)₃ ทั้งสองชนิดนี้เป็นฟิล์มที่สามารถช่วยในการต้านทานการกัดกร่อน ให้กับชิ้นงานได้ (Ying, L., Li, Q., Fuihui, W., 2003) แต่ทั้งนี้ TiO₂ เป็นสารประกอบที่มีเสถียรภาพ และความสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า Ti(OH)₃ (Bharat, A., Pradeep H. 2010)

$$2\operatorname{CrN}(s) + 2\operatorname{H}_{2}O(\operatorname{aq}) \longrightarrow 2\operatorname{CrO} + \operatorname{N}_{2}(g) + 2\operatorname{H}_{2}(g)$$

$$(4.8)$$

$$2\operatorname{CrO}(s) + \operatorname{H}_{2}\operatorname{O}(\operatorname{aq}) \longrightarrow \operatorname{Cr}_{2}\operatorname{O}_{3}(s) + \operatorname{H}_{2}(g)$$
(4.9)

$$\operatorname{Cr}(s) + 2\operatorname{OH}(aq) \longrightarrow \operatorname{Cr}(\operatorname{OH})_2(s) + e^{-1}$$

$$(4.10)$$

$$2\text{TiN} + 2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{TiO}_2 + \text{N}_2 \tag{4.11}$$

$$\operatorname{TiN} + 2\operatorname{H}_{2}\operatorname{O} \longrightarrow \operatorname{TiO}_{2} + 1/2\operatorname{N}_{2} + 4\operatorname{H}^{+} + 4\operatorname{e}^{-}$$

$$(4.12)$$

$$TiN + 3H_2O \longrightarrow Ti(OH)_3 + N_2 + 3H^+ + 3e$$
(4.13)

4.3.3 ผลของค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน ในงานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาผลของความหยาบผิวของวัสดุหรือเหล็กกล้า

AISI 4140 ที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความ เข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 จึงได้มีการวัดความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทแทเนียม ในไตรด์ (ดังแสดงในตารางที่ 3.3 3.4 และ 3.5 ในบทที่ 3) พบว่าความหยาบผิวของชิ้นงานจะมีก่า ลคลงเมื่อกระดาษที่ใช้ในการขัดผิววัสดุมีความละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าความหยาบผิว ของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการเคลือบผิวมีผลต่อความหยาบผิวภายหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์ม บางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ซึ่งแนวโน้มค่าความหยาบผิวของชิ้นงาน ภายหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับความหยาบผิวของเหลีกกล้า AISI 4140 ก่อนการเคลือบผิว รูปที่ 4.31 ถึง 4.33 แสดงค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่มีก่า ความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ พบว่าก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของ ชิ้นงานมีก่าเปลี่ยนแปลงไปตามก่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ทุกค่าพีเอช โดยที่ก่า พีเอช 2 และ 10 พบว่าเมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ค่าศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวมีแนวโน้มมีก่าลดลง ส่วนที่ก่าพีเอช 7 นั้นเมื่อก่าความหยาบ ผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบผิวมี แนวโน้มมีก่าเพิ่มมากขึ้น และพบว่าเมื่อก่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ค่าศักย์ไฟฟ้าการ ก้ดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเลลือบผิวมีแนวโน้มมีก่าลดลง ส่วนที่ก่าพีเอช 7 นั้นเมื่อก่าความหยาบ ผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบผิวมี แนวโน้มมีก่าเพิ่มมากขึ้น และพบว่าเมื่อก่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวค้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มี แนวโน้มลดลงที่ทุกค่าพีเอช ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานมีเสถียรภาพ



รูปที่ 4.31 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่มีค่าความหยาบผิว ของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.32 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกัน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.33 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม ใน ไตรด์ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกัน ในสารละลาย โซเดียมคลอ ไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10

รูปที่ 4.34 ถึง 4.36 แสดงค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ ใม่ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่มีค่าความหยาบผิว ของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดย น้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 พบว่าเมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ก่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวมีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนที่ค่าพีเอช 2 และ 7 ส่วนที่ค่าพีเอช 10 เมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ล่าดร่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับที่ค่าพีเอช 2 และ 7 นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการ กัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน คือ เมื่อค่าความหยาบผิวของ เหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีแนวโน้มการเปลี่ยนเปลงเช่นเดียวกัน คือ เมื่อค่าความหยาบผิวของ เหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานมีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง ชัดเจนที่ค่าพีเอช 2 ส่วนที่ค่าพีเอช 7 และ 10 เมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้นอย่าง ชัดเจนที่ค่าดัเอช 2 ส่วนที่ค่าพีเอช 7 และ 10 เมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้นอย่าง ชัดเจนที่ค่าด้าอัตราการกัดกร่อนมีการเพิ่มขึ้นแล้กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับก้าด้า AISI 4140 เพิ่มมาก



รูปที่ 4.34 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่มีค่าความหยาบผิว ของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10


รูปที่ 4.35 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.36 ก่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ใทเทเนียมในไตรค์ที่มีก่ากวามหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 แตกต่างกันในสารละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10

้ากผลของศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่ ้ ค่าความหยาบผิวของวัสดุที่มากขึ้น ส่งผลให้ชิ้นงานเกิดการกัดกร่อนมากขึ้นหรือมีความสามารถ ้ต้านทานการกัดกร่อนลดลง เนื่องจากชิ้นงานที่มีความหยาบผิวที่มากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ ้เรียบและไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวทำให้มีพื้นที่ที่สารละลายสามารถเข้าไปทำการกัดกร่อนผิวหน้าได้ ้มากขึ้น และหลังการเคลือบฟิล์มบางบนผิววัสดุที่มีค่าความหยาบผิวมากขึ้น อาจทำให้ฟิล์มบางที่ได้ หลังกระบวนการเคลือบผิวมีปริมาณข้อบกพร่องที่มากขึ้น และทำให้การยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์ม และวัสคลคลง จึงส่งผลให้คณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนของชั้นฟิล์มลคลง (Walter, R., Bobby Kannan, M., 2011; Durst, O., Ellermeier, J., Berger, C., 2008) นอกจากนี้จากกราฟโพลาไรเซชั่น (รูปที่ 4.10 4.13 และ 4.16) พบว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวที่ละเอียดที่สุด คือ ชิ้นงาน B3 ที่ก่าพีเอช 10 ชิ้นงาน C3 ที่ค่าพีเอช 7 และ 10 และชิ้นงาน T3 ที่ค่าพีเอช 10 แสคงให้เห็นถึงพาสซีฟฟิล์ม (passive film) เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงาน ซึ่งพาสซีฟฟิล์มที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถช่วยต้านทานการ ้กัดกร่อนได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความหยาบผิวของวัสดุก่อนการเกลือบผิวนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญ ต่อคณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียม ในไตรด์ กล่าวคือ เมื่อทำการเกลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ้บนวัสดุที่มีค่าความหยาบผิวลดลง สามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงาน ให้ดียิ่งขึ้น (Shen-Chih, Lee, Wei-Yu, H., Lai, F.D. 1996; Liu, C., Leyland, A., Lyon, S., Matthews, A. 1995)

4.4 คุณลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์หลังทดสอบการกัดกร่อน
4.4.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ส่งย กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)

รูปที่ 4.37 ถึง 4.39 แสดงภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ ถูกเคลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ พบว่าพื้นผิวชิ้นงานที่ไม่ถูก เคลือบผิวถูกกัดกร่อนและมีผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนเกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานมากกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบ ผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์และขึ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่ทุก ค่าพีเอช อาจเป็นผลเนื่องจากชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบเป็นชิ้นงานเปลือยไม่มีฟิล์มบางเกลือบผิวเพื่อ ป้องกันการกัดกร่อนจากสารละลาย พื้นผิวจึงถูกกัดกร่อนจากสารละลายได้ง่ายกว่าชิ้นงานที่ถูก เกลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โดยร่องรอยการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบผิวนั้นมี ลักษณะการกัดกร่อนแบบทั่วไป (general corrosion) กล่าวกือ ชิ้นงานจะถูกสารละลายกัดกร่อนทั่ว ทั้งผิวหน้า ซึ่งสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานที่ไม่ถูกเกลือบผิวนั้นมี ลักษณะการกัดกร่อนแบบทั่วไป (general corrosion) กล่าวกือ ชิ้นงานจะถูกสารละลายกัดกร่อนทั่ว ทั้งผิวหน้า ซึ่งสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งผิวหน้าชิ้นงาน ในขณะที่ ผิวของฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ จะเกิดการกัดกร่อนเฉพาะที่ (localized corrosion) ฟิล์มจะถูกกัดกร่อนเกิดเป็นรอยแตกเฉพาะบางปริเวณบนผิวของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์เท่านั้น และหากพิจารณาเปรียบเทียบพื้นผิวของ ชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์ และชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียมในไตรด์สงาดสอบการกัดกร่อน พบว่าที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ มีร่องรอยการกัดกร่อนบนผิวชิ้นงานมากกว่าชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์ เพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณที่ถูกกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นของ ชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความหยาบผิวของวัสดุและค่าพีเอชของ สารละลาย โดยเมื่อค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เพิ่มมากขึ้น บริเวณที่ถูกกัคกร่อน และปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ทุกก่าพีเอช และเป็นที่สังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงาน B1 และ B2 (ขัดด้วยกระดาษ เบอร์ 180 และ 600 ตามลำคับ) จะเกิดขึ้นตามรอยแนวขัดของกระดาษทราย ส่วนผลิตภัณฑ์การ กัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงาน B3 (ขัดด้วยกระดาษเบอร์ 1200) มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก และกระจายทั่วผิวหน้าชิ้นงาน แสดงให้เห็นว่าผลของการขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายที่แตกต่าง ้กัน ส่งผลต่อการเกิดการกัดกร่อนบนผิวชิ้นงาน และพบว่าบริเวณที่ถูกกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การ ้กัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานที่ถกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงานที่ถก ้เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 เช่นเดียวกันกับชิ้นงานที่ไม่ถกเคลือบผิว กล่าวคือ เมื่อเคลือบฟิล์มบางบนเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีค่าความหยาบผิวมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณที่ถูกกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อน บนผิวของชิ้นงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนที่ก่าพีเอช 2 โดยจะเห็นชัดเจนได้ว่าชั้นฟิล์มบางส่วนของ ชิ้นงาน C1 และ T1 ที่ค่าพีเอช 2 ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 มาก ที่สุด พบว่ามีรอยแตกและหลุดออกจากผิวชิ้นงานหลังทดสอบการกัดกร่อน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก ้ความหยาบผิวของวัสคพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้ภายหลังการเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมไนไตรด์ นั้นผิวชิ้นงานเกิดกวามไม่สม่ำเสมอ และมีการยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์มและผิววัสดุลดลง ทำให้เกิด รอยแตกบนผิวฟิล์มบางและหลุดออกจากผิววัสดุขณะทดสอบการกัดกร่อนเป็นสาเหตุให้ สารละลายสามารถแทรกซึมผ่านชั้นฟิล์มเข้าไปกัดกร่อนผิววัสดุได้ง่ายขึ้น ส่วนที่ก่าความหยาบผิว ของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ลดลง จะพบรอยแตกของชั้นฟิล์มและปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่ น้อยลงตามลำดับ สำหรับที่ก่าพีเอช 7 และ 10 นั้น พบว่าเมื่อก่าความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ลดลง พื้นผิวของชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์และชิ้นงานที่ถูก เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลังการทดสอบการ กัดกร่อน นอกจากนี้ได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูก เกลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เกลือบ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทรเมียมไนไตรด์ และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเกเนียมในใตรก่อนทดสอบการกัดกร่อนดัง แสดงในภากผนวก ง เพื่อให้เห็นกวามแตกต่างของลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานก่อนและหลังทดสอบ การกัดกร่อน

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของผลการ เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ผลของก่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) และความหยาบผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของ ชิ้นงาน (ในหัวข้อ 4.2.1 4.2.2 และ 4.2.3) ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเคลือบผิววัสดุด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์และฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ก่าพีเอชของสารละลายที่เพิ่มขึ้น และก่าความ หยาบผิวที่ลดลงจะส่งผลให้ชิ้นงานมีการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น



รูปที่ 4.37 ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์และชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสาร ละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ 4.38 ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์และชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์ในสาร ละลายโซเดียมคลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ 4.39 ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์และชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในสาร ละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10

นอกจากการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานหลังการทดสอบการกัดกร่อนด้วย ึกล้อง SEM แล้วได้มีการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี ณ บริเวณร่อยรอยการกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์ การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานด้วยเทกนิค EDX ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกับกล้อง SEM โดยจะ ้ยกตัวอย่างการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี ณ บริเวณที่ถูกกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่ เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงาน B1 C1 และ T1 หลังทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2 ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานที่ถูก ้เคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรด์ที่มีการเกิด กัดกร่อนมากที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.40 ถึง 4.42 ตามลำดับ หลังการตรวจสอบส่วนผสม ทางเกมีบนพื้นผิวชิ้นงาน B1 และ C1 พบว่าบริเวณที่ถูกกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่ เกิดขึ้นหรือบริเวณ 1 มีธาตุเหล็ก (Fe) และธาตุออกซิเจน (O) เป็นส่วนผสมทางเคมีเป็นหลัก ซึ่งธาตุ Fe และ O ที่พบอาจเป็นส่วนผสมทางเคมีของเหล็กออกไซด์ที่เกิดจากสารละลายเข้าไปกัดกร่อน ้โดยตรงที่ผิววัสดุของชิ้นงาน B1 และเกิดจากสารละลายแพร่ซึมผ่านชั้นฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ เข้าไปกัคกร่อนผิววัสคุของชิ้นงาน C1 จนเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ขึ้นบนผิวชิ้นงาน สำหรับบริเวณที่ ถกกัดกร่อนของชิ้นงาน T1 หลังการตรวจสอบพบธาต Fe เป็นส่วนผสมทางเคมีเป็นหลัก ซึ่ง สามารถระบุได้ว่าบริเวณนี้ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ถูกกัดกร่อนจนหลุดออกจากผิววัสดุจนหมด จึงพบธาตุ Fe ที่เป็นส่วนผสมหลักของวัสดุเพียงอย่างเดียว และเนื่องจากบริเวณนี้ไม่พบผลิตภัณฑ์ การกัคกร่อนบนผิวชิ้นงาน จึงไม่พบธาตุ O เช่นเคียวกับกรณีชิ้นงาน B1 และ C1 ในขณะเคียวกัน ใด้ทำการวิเคราะห์บริเวณที่ไม่ถูกกัดกร่อนหรือบริเวณ 2 เพื่อให้เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบ ทางเคมีหลังการทดสอบการกัดกร่อนระหว่างบริเวณที่ถูกกัดกร่อนและไม่ถูกกัดกร่อนอีกด้วย โดย บริเวณ 2 ของชิ้นงาน B1 พบองค์ประกอบของธาตุเหล็ก (Fe) เป็นหลัก ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบ หลักของวัสดหรือเหล็กกล้ำ AISI 4140 ส่วนชิ้นงาน C1 พบองค์ประกอบของธาตุโครเมียม (Cr) และ ในโตรเจน (N) ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ และชิ้นงาน T1 พบองก์ประกอบของธาตุไทเทเนียม (Ti) และในโตรเจน (N) เป็นหลัก ซึ่งเป็นธาตุองก์ประกอบ หลักของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ (สำหรับการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี ณ บริเวณร่องรอย การกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนของชิ้นงานอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก ง)



รูปที่ 4.40 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเกมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B1หลังทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ 4.41 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C1 หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ 4.42 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเกมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T1 หลังทคสอบการกัคกร่อนในสารละลายโซเคียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2

4.4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

รูปที่ 4.43 แสคงผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ์ โครเมียมในไตรค์ก่อนและหลังทคสอบการกัคกร่อน โดยชิ้นงาน C1 ที่ก่าพีเอช 2 และชิ้นงาน C3 ที่ ้ ค่าพีเอช 10 หลังทคสอบการกัดกร่อนถูกเลือกเพื่อตรวจสอบค้วยเทคนิค XPS เพราะชิ้นงานคังกล่าว เป็นชิ้นงานที่มีอัตราการกัดกร่อนสูงที่สุด และเป็นชิ้นงานที่มีอัตราการกัดกร่อนต่ำที่สุด ตามลำดับ จากการตรวจสอบพบส่วนผสมทางเกมีที่ก่าระดับพลังงาน 577.5 (587.8), 399.4, 533.8 และ 287.8 eV ซึ่งค่าระดับพลังงานดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกับค่าระดับพลังงานของธาตุ Cr 2p_{vo}, O 1s, N 1s และ C 1s ตามถำดับ (Emery, C., Chourasia A.R., Yashar, P., 1999; A.Vyas and et al., 2008; Vyas, A., Shen, Y.G., Zhou, Z.F., Li, K.Y., 2005; Bertoti, I. 2002) และพบว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วย โครเมียมในไตรด์ก่อนการทดสอบการกัดกร่อนพบการปรากฎของธาตุโครเมียมและในโตรเจน ้อย่างชัดเจน แต่หลังการทดสอบการกัดกร่อน พบว่าชิ้นงาน C1 ที่ค่าพีเอช 2 และชิ้นงาน C3 ที่ค่า พีเอช 10 มีปริมาณของธาตุโครเมียมลุคลงแทบจะไม่ปรากฎเห็นบนเส้นสเปกตรัม และชิ้นงาน C1 ที่ค่าพีเอช 2 มีปริมาณในโตรเจนที่ลคลงจนแทบจะปรากฏเห็นบนเส้นสเปกตรัมเช่นเคียวกัน แต่ ้ชิ้นงาน C3 ที่ค่าพีเอช 10 นั้นยังพบปริมาณชาตุในโตรเจนอยู่เล็กน้อย จากผลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า หลังการทดสอบการกัดกร่อนฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่เคลือบบนผิววัสดุได้ถูกกัดกร่อนจนฟิล์ม บางส่วนได้หลุดออกจากพื้นผิววัสดุ ส่งผลทำให้ปริมาณของธาตุโครเมียมและในโตรเจนลดลง ้อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ของชิ้นงาน C3 ที่ค่าพีเอช 10 ถูก กัดกร่อนน้อยกว่าชิ้นงาน C1 ที่ค่าพีเอช 2 จึงยังพบธาตุในโตรเจนปรากฏอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน ้ธาตุออกซิเจนและคาร์บอนที่ถูกตรวจพบบนพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ก่อนการทคสอบ การกัคกร่อน และชิ้นงาน C3 ที่ค่าพีเอช 10 นั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นธาตุออกซิเจนและคาร์บอน ที่เป็นสารมลทินอย่ในอากาศทั่วไป หรือจากกระบวนการเคลือบไอทางกายภาพ (Tunmee. S. Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N., Wongpanya, P., 2011) หรือเป็นธาตุ ้ออกซิเจนที่มาจากการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และธาตุออกซิเจนที่ถูกตรวจ พบในชิ้นงาน C1 ที่ค่าพีเอช 2 พบว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเกิดออกซิเดชันที่มากขึ้น เนื่องจากการกัดกร่อนที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็พบว่าค่าระดับพลังงานของธาตุโครเมียมที่ถูกตรวจบน ้ผิวของชิ้นงานก่อนทคสอบการกัดกร่อนพบมีค่าใกล้เคียงกับค่าพลังงานของโครเมียมออกไซด์ (Cr₂O₂) ตามรายงานวิจัยของ (Fenker, M., Balzer, M., Kappl, H, 2006) ซึ่งอาจเกิดจากธาตุโครเมียม ในเนื้อฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิคเป็นสารประกอบ Cr₂O₃ โดย สารประกอบชนิดนี้เป็นฟิล์มที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี



รูปที่ 4.43 ผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ ก่อนและหลังทดสอบการกัดกร่อน

4.4.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

รูปที่ 4.44 แสดงผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยด้วยฟิล์ม บางไทเทเนียมในไตรค์ก่อนและหลังทคสอบการกัดกร่อน โดยชิ้นงาน T1 ที่ค่าพีเอช 2 และชิ้นงาน T3 ที่ค่าพีเอช 10 หลังทคสอบการกัดกร่อนถูกเลือกเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค XPS เพราะชิ้นงาน ดังกล่าวเป็นชิ้นงานที่มีอัตราการกัดกร่อนสูงที่สุด และเป็นชิ้นงานที่มีอัตราการกัดกร่อนต่ำที่สุด ตามลำคับ จากการตรวจสอบพบส่วนผสมทางเคมีที่ค่าระดับพลังงาน 463.1, 535.2 และ 289.8 eV ซึ่งค่าระคับพลังงานดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกับค่าระดับพลังงานของธาตุ Ti 2p_{3/2}, O 1s, และ C 1s ตามลำคับ (Diana, L., Carlos, S., Alejandro, T., 2005; Subramanian, B., Muraleedharan, C.V., Ananthakumat, R., Jayachandran., 2011; Milosev, I., Strehblow, H.-H., Navinsek, B., 1995; Bertoti, I. 2002) แต่ไม่พบการปรากฏของค่าระดับพลังงานของธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็น องก์ประกอบหลักของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ (อาจเป็นผลเนื่องจากธาตุลาร์บอนที่เป็นสาร ้มลทินมีอยู่มากบนพื้นผิว ส่งผลให้สเปกตรัมของธาตุในโตรเจนไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัคเจน) และพบว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรด์ก่อนการทดสอบการกัดกร่อนพบการ ปรากฏของธาตุ ไทเทเนียมอย่างชัดเจน แต่หลังการทดสอบการกัดกร่อนพบว่าชิ้นงาน T1 ที่ก่าพีเอช 2 และชิ้นงาน T3 ที่ค่าพีเอช 10 มีปริมาณของธาตุไทเทเนียมลดลงแทบจะไม่ปรากฏเห็นบนเส้น สเปกตรัม และพบว่าธาตุออกซิเจนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ชิ้นงาน T1 ที่ค่าพีเอช 2 มีแนวโน้มมี ้ปริมาณของธาตุออกซิเจนที่มากกว่าชิ้นงาน T3 ที่ค่าพีเอช 10 จากผลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าหลังการ ทคสอบการกัคกร่อนฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ถูกกัคกร่อนจนฟิล์มบางส่วนได้หลุดออกจาก ้พื้นผิววัสดุ จึงส่งผลให้ปริมาณของธาตุไทเทเนียมลดลง และปริมาณของธาตุออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น หลังทดสอบการกัดกร่อนกาดว่าเป็นผลมาจากการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ หรือการเกิดออกซิเดชันของวัสดุในกรณีที่ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์หลุดออกจากผิววัสดุขณะ ทคสอบการกัดกร่อน โดยชิ้นงาน T1 ที่ค่าพีเอช 2 พบปริมาณของธาตุออกซิเจนที่มากกว่าชิ้นงาน T3 ที่ค่าพีเอช 10 เนื่องจากถกกัดกร่อนมากกว่า จึงส่งผลให้เกิดการออกซิเดชันมากขึ้น อย่างไรก็ ตามพบว่าค่าระดับพลังงานของธาตุไทเทเนียมที่ถูกตรวจพบบนผิวของชิ้นงานก่อนทดสอบการ กัดกร่อนมีค่าใกล้เคียงกับค่าพลังงานของไทเทเนียมใดออกไซด์ (TiO,) ตามรายงานวิจัยของ (Ananthakumar, R., Subramanian, Akira, K., Jayachandran M., 2011) ซึ่งอาจเกิดจากธาตุ ไทเทเนียมเนื้อฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ค์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิคเป็นสารประกอบ TiO, ้โดยสารประกอบชนิดนี้เป็นฟิล์มที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าค่าระดับ พลังงานของธาตุออกซิเจนที่ถูกตรวจบนผิวของชิ้นงาน T1 ที่ค่าพีเอช 2 มีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 535.2 ไปเป็น 533.8 eV แสดงให้เห็นว่า oxidation state ของธาตุออกซิเจนเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังไม่ เป็นที่แน่ชัดว่าเป็น oxidation state ในรูปแบบใด ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการทคสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

จากผลของการทคสอบด้วยเทคนิค XPS ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และ การวิเคราะห์ผลของสเปกตรัมยังมีสัญญาณรบกวนในกระบวนการวัคอยู่มาก โดยอาจจะเกิดจาก สมรรถนะของเครื่อง XPS ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการทำการวิจัยและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ แม่นยำ และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านกระบวนการเคลือบผิวโลหะได้มากยิ่งขึ้น



รูปที่ 4.44 ผลสเปกตรัมของ XPS ของชิ้นงานที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ก่อนและหลังทดสอบการกัดกร่อน



บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่าฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์มี โครงสร้างผลึกระนาบ (111) (200) (220) และ (311) โดยมีระนาบ (111) เป็น preferred orientation

5.1.2 จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิก XRD พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์มี โครงสร้างผลึกระนาบ (111) (200) (220) และ (311) โดยมีระนาบ (111) เป็น preferred orientation

5.1.3 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์มีความสามารถ ด้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่ทุกค่าพีเอช

5.1.4 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มี ความสามารถด้านทานการกัดกร่อนดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียมในไตรด์

5.1.5 ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ลดลง ส่งผลให้ชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีความสามารถ ต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้น

5.1.6 ค่าพีเอชของสารละลายที่ใช้ในการทคสอบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวค้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวค้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรค์มีความสามารถ ด้านทานการกัคกร่อนดีขึ้น

5.1.7 ชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยโครเมียมในไตรด์และชิ้นงาน เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมในไตรด์หลังทดสอบการกัดกร่อนมีพื้นที่ถูก กัดกร่อนและปริมาณผลิตการกัดกร่อนที่น้อยกว่าชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และค่าความหยาบผิวที่ลดลงและสารละลายที่มีก่าพีเอชเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมีพื้นที่ถูกกัด กร่อนและปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่ลดลง

5.2 ข้อเสนอแนะ

พฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในใตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในใตรด์ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร เช่น ชนิดของฟิล์มที่ เคลือบบนผิวชิ้นงาน ความหยาบผิวของวัสดุพื้นก่อนการเคลือบผิว ค่าพีเอชของสารละลายหรือ สภาวะแวคล้อมที่มีฤทธิ์การกัดกร่อน ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ศึกษาผลของตัวแปรเหล่านี้ โดยได้ ทดลองและผลการทคลองดังแสดงในบทที่ผ่านมา แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น แต่เพื่อ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริงควรมีการทำวิจัยศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นผู้ทำวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ในการทำวิจัยต่อไป ดังนี้

5.2.1 ควรเพิ่มความหนาของชั้นฟิล์มให้อยู่ระดับ 2-3 ไมครอนเมตรขึ้นไป เพื่อการใช้ งานได้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะทำการเคลือบผิววัสดุด้วยชั้นฟิล์มที่มีความหนาใน ระดับนี้

5.2.2 ควรปรับก่าความหยาบผิวของวัสดุพื้นให้มีหลายช่วงก่าความหยาบ เพื่อให้เห็น ความแตกต่างของพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานที่มีก่าความหยาบผิวต่างกันได้ชัดเจน

ความหยาบที่ 1 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180
ความหยาบที่ 2 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320
ความหยาบที่ 3 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600
ความหยาบที่ 4 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 800
ความหยาบที่ 5 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1200
ความหยาบที่ 6 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 2000
ความหยาบที่ 7 เตรียมผิวด้วยผงอะลูมิน่า
ความหยาบที่ 8 เตรียมผิวด้วยผงเพชรความละเอียด 1 ใมครอน
ความหยาบที่ 9 เตรียมผิวด้วยผงเพชรความละเอียด 3 ไมกรอน
ควรมีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของชั้นฟิล์มเพิ่มเติม เช่น ค่าความแข็ง

5.2.3 ควรมีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของชั้นฟิล์มเพิ่มเติม เช่น ค่าความแข็ง ความสามารถในการยึดเกาะ และอัตราการสึกหรอของชั้นฟิล์ม เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ร่วมกับ ผลทางด้านพฤติกรรมการกัดกร่อน

รายการอ้างอิง

- ประทีป วงศ์บัณฑิต. (2543). การสร้างแผนภูมิพอร์แบซ์ของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ในสารละลายที่ มีคลอไรค์ผสม ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์. (2544). ผลของในโตรเจนต่อความด้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า ใร้สนิมชนิดออสเตนนิติกเกรด 304L. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อภิชิต พันธ์เสถียร. (2552). การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานกากรัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม หล่อเกรด 201 และเหล็กกล้าไร้สนิมหล่อเกรด 304. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Ahmad, Z. 2006. Principles of corrosion engineering and corrosion control. Institution of Chemical Engineering.
- Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G. (2002). A study on corrosion resistance characteristics of PVD Cr-N coated steels by electrochemical method. Surface and Coatings Technology. (150): 319-326.
- Altun, H., Sen, S.i. (2004). Studies on the influence of chioride ion concentration and pH on the corrosion and electrochemical behavior of AZ63 magnesium alloy. Material and Design. (25): 637-643.
- Ananthakumar, R., Subramanian, Akira, K., Jayachandran, M. (2011). Electrochemical corrosion and material properties of reactively sputtered TiN/TiAlN multilayer coatings. Ceramics International:1-9.
- Bertoti, I. (2002). Characterization of nitride coatings by XPS. Surface and Coatings Technology. (151-152): 194-203.

- Bertrand, G., Mahdjoub, H., Meunier , C. (2000). A study of the corrosion behavior and protective quality of sputtered chromium nitride coatings. Surface and Coatings Technology. (126): 199-209.
- Bharat, a., Pradeep, H. (2010). Electrochemical oxidation behavior of titanium nitride based electrocatalysts under PEM fuel cell conditions. **Electrochimica Acta**. (55): 9024-9034.
- Chen, J.Y., Yu, G.P., Huang, J.H. (2000). Corrosion behavior and adhesion of ion-plated TiN films on AISI 304 steel. Materials Chemistry and Physics. (65): 310-315
- Chyou, S. D., Shih, H. C. (1991). The Effect of nitrogen on the corrosion of plasma-nitrided 4140 Steel. **Corrosion**. (47(1)): 31-34.
- Cunha, L., Andritschky, M., Rebouta, L., Silva, R. (1998), Corrosion of TiN (TiAl)N and CrN hard coating produced by magnetron sputtering. Surface and Coatings Technology. (317): 351-355.
- Cunha, L., Andritschky M., Rebouta L., Pischow. (1999). Corrosion of CrN and TiAlN coatings in chloride-containing atmospheres. Surface and Coatings Technology. (116-119): 1152-1160.
- Darja, K.M., Peter P., Miha, C., Marijan M. (2004). The corrosion behavior of Cr-(C,N) PVD hard Coatings deposited on various substrates. **Electrochimica Acta**. (49(9-10)): 1527-1533.
- Diana, L., Carlos, S., Alejandro, T. (2005). Corrosion-erosion behavior of TiN-coated stainless steels in aqueous slurries. Wear. (258): 684-692.
- Durst, O., Ellermeier, J., Berger, C. (2008). Influence of plasma-nitridring and surface roughness on the wear and corrosion resistance if thin films (PVD/PECVD). Surface and Coatings Technology. (203): 848-854.
- Einstein, A. (1905). Ann. Physik. (17): 132.
- Emery, C., Chourasia A.R., Yashar, P. (1999). A study of CrN_x thin film by X-ray photoelectron spectroscopy. Journal of Electron Spectroscopy. (104): 91-97.

- Feng, H.P., Cheng, H.H., Jung, K.L., Yih H.S. (2003). Effects of PVD sputtered coatings on the corrosion resistance of AISI 304 stainless steel. Materials Science and Engineering A. (347): 123-129.
- Fengqun, L., Zhiming, Y. (2001). The corrosion resistance and wear resistance of thick TiN coatings deposited by arc ion plating. Surface and Coatings Technology. (145): 80-87.
- Fenker, M., Balzer, M., Kappl, H. (2006). Corrosion behavior of decorative and wear resistant coating on steel deposited by reactive magnetron sputtering-Tests and improvements.
 Thin Solid Films. (515): 27-32.
- Fontana, M. G. (1987). Corrosion Engineering. 3rd Edition, McGraw-Hill Book Company. Singapore.
- Franco, C.V., Fontana, L.C., Bechi, D., Martinelli, A.E., Muzart, J.L.R. (1998). An electrochemical study of magnetron-sputtered Ti-And TiN-coated steel. Corrosion Science. (40): 103-112.
- Grabke, H. J. (1996). The Role of nitrogen in the corrosion of iron and steels (review). ISIJ International. (36(7)): 777-786.
- Hanand, S., Lin, J.H., Tsai, S.H., Chung, S.C., Wamg, D.Y., Lu, F.H., Shih, H.C. (2000). Corrosion and tribological studies of chromium nitride coated on steel with an interlayer of electroplated chromium. Surface and Coatings Technology. (133-134): 460-465.
- Herranen, M., Wiklund U., Carlsson, J.O., Hogmark. (1998). Corrosion behavior of Ti/TiN multilayer coated tool steel. Surface and Coatings Technology. (99): 191-196.
- Hiroki, T. (2008). The role of rusts corrosion and corrosion protection of iron and steel. Corrosion science. (50): 1872-1883.
- Ibrahim, M.A.M., Korablov S.F., Yoshimura, M. (2002). Corrosion of stainless steel coated with TiN, (TiAl)N and CrN in aqueous environments. **Corrosion Science**. (44): 815-828.

- Liu, C., Leyland, A., Lyon, S., Matthews, A. (1995). An a.c impedance study on PVD-coated mild steel with different surface roughness. Surface and Coatings Technology. (76-77(part2)): 623-631.
- Liu, C., Bi, Q., Matthews, A. (2001). Corrosion resistance of multi-layered plasma-assited physical vapour deposition TiN and CrN coating. Surface and Coatings Technology. (141): 164-173.
- Liu, C., Bi, Q., Matthews, A. (2001). EIS comparison on corrosion performance of PVD TiN and CrN coated mild steel in 0.5 N NaCl aqueous solution. **Corrosion Science**. (43): 1953-1961.
- Medina-Flores, A., Arganis, C., Santiago, P., Oseguera. (2004). Electrochemicals corrosion tests of an AISI-SAE 4140 steel nitride by post-discharges wave plasma. Surface and Coatings Technology. (188-189): 140-145.
- Milosev, I., Strehblow, H.-H., Navinsek, B. (1995). XPS in the study of high-temperature oxidation of CrN and TiN hard coatings. Surface and Coatings Technology. (74-75): 897-902.
- Ming, C.Z., Ming, L., Guang, L.S., Andrej, A. (2008). Influence of pH and Chloride ion concentration on the corrosion of Mg alloy ZE41. Corrosion Science. (50): 3168-3178.
- Novakovic, M., Popovic, M., Bibic, N. (2010). Ion-beam irradiation effects on reactively sputtered CrN thin films. Beam Interactions with Materials and Atoms. (268): 2883-2887.
- Rober, G. (1998). Tool steels. 5th Edition, Materials Park. OH: ASM International.
- Rudenja, S., Kulu, P., Tallimets E., Mikli, V., Straede C.A. (1999). Duplex TiN coatings deposited by arc plating for increased corrosion resistance of stainless steel substrates. Surface and Coatings Technology. (114): 129-136.

Sedriks, A. J. (1996). Corrosion of stainless steels. 2nd Edition, John-Wiley & Sons. New York.

Shen-Chih, L., Wei-Yu, H., Lai, F.D. (1996). Effect of substrate surface roughness on the characteristics of CrN hard film. Materials Chemistry and Physics. (43): 266-273.

- Sivitski A., Ajaots M. and Podra P., (2008). Wear PVD hard coatings in sliding contacts. In the Proceedings of the 6th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering, Tallinn, Estonia: 549-554
- Souto, R.M., Alanyali, H. (2000). Electrochemical characteristics of steel coated with TiN and TiAlN coating. **Corrosion Science**. (42): 2201-2211.

Standard guide for examination and evaluation of pitting corrosion. (2005). ASTM-G46.

- Subramanian, B., Muraleedharan, C.V., Ananthakumat, R., Jayachandran. (2011). A comparative study of titanium nitride (TiN), titanium oxy nitride (TiON) and titanium aluminum nitride (TiAlN), as surface coatings for bio implants. Surface and Coatings Technology. (205): 5014-5020.
- Tunmee, S. Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N., Wongpanya, P. (2011). The study of sputtered CrN films on the AISI H13 tool steel. Proceeding of the 6th Annual Conference of the Thai Physics Society: 325-329.
- Vyas, A., Shen, Y.G., Zhou, Z.F., Li, K.Y. (2008). Nano-structured CrN/CN_x multilayer films deposited by magnetron sputtering. Composites Science and Technolgy. (68): 2922-2929.
- Walter, R., Bobby, K. M. (2011). Influence of surface roughness on the corrosion behavior of magnesium alloy. Material and Design. (32(4)): 2350-2354.
- William Grips, V.K., Harish, C.B., Ezhil Selvi, V., Kalavati, Rajam K.S.. (2006). Electrochemical behavior of single layer CrN, TiN, TiAlN caotings and nanolayered TiAlN/CrN multilayer coatings prepared by reactive direct current magnetron sputtering. Thin Solid Films. (514): 204-211.
- Yang, J., Ping Yu, G., Hong H.J. (2000). Corrosion behavior and adhesion of ion-plated TiN films on AISI 304 steel. Material Chemistry and Physics. (65): 310-315.
- Ying, L., Li, Q., Fuihui, W. (2003) The electrochemical corrosion behavior of TiN and (Ti,Al)N coating in acid and salt solution. **Corrosion Science**. (45): 1367-1381.

- You, H. –xia., Xu, H.-bin., Zhang, Y., Zheng, S.-li., Gao, Y.-ying. (2010). Potential-pH diagrams of Cr-H₂O system at elevated temperatures. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. (20): s26-s31.
- Zaid, B., Saidi, D., Benzaid, A., Hadji, S. (2008). Effects of pH and chloride concentration on pitting corrosion of AA6061 aluminum alloy. Corrosion Science. (50): 1841-1847.
- Zhou, Q.G., Bai, X.D., Chen, X.W., Peng, D.Q., Ling, Y.H., Wang, D.R., (2003). Corrosion
 Resistance of Duplex and Gradient CrN_x Coated H13 Steel. Applied Surface Science.
 (211(1-11)): 293-299.



ภาคผนวก ก

การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และการคำนวณอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไตรด์ การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของขึ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ขึ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์

ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและและค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานภายหลัง ทดสอบการกัดกร่อนหาได้จากการใช้โปรแกรมลีเนียร์รีเกรสชัน (linear regression program) ที่อยู่ ในเครื่อง AUTOLAB PGSTAT 302H ซึ่งมีวิธีการหาโดยกำหนดตำแหน่ง 2 จุดบนบนเส้นโด้ง โพลาไรเซชันแล้วใช้คำสั่งทำลีเนียร์รีเกรสชัน โปรแกรมจะทำการกำนวณเส้นตรงระหว่างจุด 2 จุด ที่กำหนดไว้ดังรูปที่ ก.1 ซึ่งแสดงจุดตัดระหว่างเส้นความชันของเส้นกราฟช่วงที่เกิดปฏิกิริยา แอโนด และเส้นความชันของเส้นกราฟช่วงที่เกิดปฏิกิริยาแคโทด โดยที่จุดตัดนี้จะสามารถหาค่า ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนได้



รูปที่ ก.1 วิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและและค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนจากเส้นโพลาไรเซชัน

การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงาน เหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์

การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนสามารถหาได้จากการนำค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า การกัดกร่อนที่อ่านได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน น้ำหนักสมมูลของโลหะ และความหนาแน่นของ โลหะ แทนลงในสมการที่ ก.1 โดยค่าอัตราการกัดกร่อนที่คำนวณได้จะแสดงผลในหน่วยมิลลิเมตร ต่อปี

$$R_{mm/year} = (0.00327 * I_{corr} * e) / \rho$$

โดยที่	R _{mm/year}	คือ	อัตราการเกิดการกัดกร่อน
			(มิลลิเมตรต่อปี)
	I _{corr}	คือ	ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน
			(ไมโครแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร)
	e	คือ	น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ
	ρ	คือ	ความหนาแน่นของโลหะ
			(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
		С.	

(ก.1)

ภ<mark>าค</mark>ผนวก ข

ข้อมูลดิบที่ได้จากการวัดเส้นโพลาไรเซชัน ที่ทำการทดลองจากเครื่องโพเทนชิโอสแตท

ชิ้นงาน	ครั้งที่			ว่านี้แมนแมวกรรวม
	1	2	пинио	ย แบบงกานทางเท่างี่เห
B1	-572	-638	-605	46.67
B2	-636	-642	-639	4.24
В3	-572	-568	-570	2.83
C1	-538	-531	-534.5	4.95
C2	-531	-538	-534.5	4.95
C3	-532	-540	-536	5.66
T1	-548	-524	-536	16.97
T2	-541	-580	-560.5	27.58
Т3	-502	-502	-502	0.00

ตารางที่ ข.1 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2

ตารางที่ ข.2 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2

2 2 2 2 2 2	ครั้งที่		-220	
ชนงเน	7151	2	ที่แหล่อ	ย แบบจะบนมาตรฐาน
B1	0.1289	0.1348	0.1318	0.0041
B2	0.0652	0.0610	0.0631	0.0029
В3	0.0609	0.0663	0.0636	0.0039
C1	0.0219	0.0221	0.0220	0.0002
C2	0.0059	0.0095	0.0077	0.0025
С3	0.0026	0.0028	0.0027	0.0001
T1	0.0237	0.0020	0.0129	0.0153
T2	0.0238	0.0017	0.0128	0.0156
Т3	0.0039	0.0041	0.0040	0.0001

ชิ้นงาน	ครั้งที่			ว่าเรื่องและการสาว
	1	2	ті ілжыо	ย เยองเอ เม เท เข เม เข
B1	-533	-537	-535	2.83
B2	-532	-539	-535.5	4.95
В3	-599	-598	-598.5	0.71
C1	-485	-568	-526.5	58.69
C2	-455	-529	-492	52.33
C3	-405	-418	-411.5	9.19
T1	-476	-461	-468.5	10.61
T2	-455	-457	-456	1.41
Т3	-426	-472	-449	32.53

ตารางที่ ข.3 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 7

ตารางที่ ข.4 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 7

สี่บงาบ	ครั้งที่		ด่าเจลี่ย	ด่าเบี่ยงบบบาตรสาบ
	1	2		N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
B1	0.0952	0.0930	0.0941	0.0016
B2	0.0399	0.0662	0.0531	0.0186
В3	0.0071	0.0067	0.0069	0.0003
C1	0.0023	0.0021	0.0022	0.0001
C2	0.0018	0.0016	0.0017	0.0001
C3	0.0011	0.0014	0.0012	0.0003
T1	0.0020	0.0019	0.0019	0.0001
T2	0.0016	0.0017	0.0017	0.0000
Т3	0.0007	0.0006	0.0006	0.0001

113

2	ครั้งที่		-222	ว่าเรื่องและการสาว
10414	1	2	ពាររដល	ที่เดือนการทาง เม
B1	-587	-577	-582	7.07
B2	-596	-594	-595	1.41
В3	-560	-558	-559	1.41
C1	-473	-458	-465.5	10.61
C2	-423	-420	-421.5	2.12
C3	-354	-485	-419.5	92.63
T1	-459	-480	-469.5	14.85
T2	-477	-450	-463.5	19.09
Т3	-433	-449	-441	11.31

ตารางที่ ข.5 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10

ตารางที่ ข.6 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10

2	ครั้งที่		dun du	. d
ชนาน	1	2	ท แนดย	แ แกถงเกหท เดวอี เห
B1	0.0080	0.0088	0.0084	0.0006
B2	0.0079	0.0069	0.0074	0.0007
В3	0.0053	0.0055	0.0054	0.0001
C1	0.0021	0.0022	0.0021	0.0001
C2	0.0017	0.0016	0.0017	0.0001
C3	0.0003	0.0011	0.0007	0.0006
T1	0.0021	0.0021	0.0021	0.0000
Т2	0.0017	0.0036	0.0019	0.0003
Т3	0.0019	0.0021	0.0020	0.0001

ภาคผนวก ค

ค่าพีเอชของชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูก เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ก่อนและหลังการทดสอบการกัดกร่อน

ชิ้นงาน	ค่าพีเอชก่อนการทดสอบการกัดกร่อน	ค่าพีเอชหลังการทดสอบการกัดกร่อน
	2.00	1.93
B1	7.00	6.25
	10.00	7.26
	2.00	1.95
B2	7.00	6.50
	10.00	7.45
	2.00	1.97
В3	7.00	6.55
	10.00	7.90

ตารางที่ ค.1 ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140

ตารางที่ ค.2 ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการกัคกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูก เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์

ชิ้นงาน	ค่าพีเอชก่อนการทดสอบการกัดกร่อน	ค่าพีเอชหลังการทดสอบการกัดกร่อน	
	2.00	2.10	
C1	7.00	6.78	
	10.00	8.32	
	2.00	2.13	
C2	7.00	6.80	
	10.00	8.34	
	2.00	2.15	
C3	7.00	6.53	
	10.00	7.81	

ตารางที่ ค.3	ร ค่าพีเอชก่อนและหลังการทคสอบการ	กัดกร่อนของชิ้นงานเ	หลีกกล้ำ AISI 4140 ที่ถูก
	เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไน'	โตรค์	

ชิ้นงาน	ค่าพีเอชก่อนการทคสอบการกัคกร่อน	ค่าพีเอชหลังการทคสอบการกัคกร่อน
	2.00	2.11
T1	7.00	6.04
	10.00	7.95
	2.00	2.00
T2	7.00	6.53
	10.00	7.65
	2.00	2.04
Т3	7.00	6.14
	10.00	7.51



ภาคผนวก ง

ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ก่อนทดสอบการกัดกร่อน



รูปที่ ง.1 ภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ก่อนทดสอบการกัดกร่อน

ภาคผนวก จ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค EDX ของชิ้นงานเหล็กกล้าAISI4140 ชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ถูกเคลือบ ผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูก เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ก่อนและหลังการทดสอบการกัดกร่อน


รูปที่ จ.1 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเกราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ จ.2 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ จ.3 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B1 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ จ.4 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ จ.5 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ จ.6 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B1 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.7 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.8 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน B3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.9 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 2



รูปที่ จ.10 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C3 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ จ.11 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C1 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ จ.12 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 7



รูปที่ จ.13 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C3 ภายหลังทคสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ จ.14 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C1 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.15 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C2 ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.16 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน C3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ จ.17 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ จ.18 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ จ.19 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T1 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ จ.20 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ จ.21 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ จ.22 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T1 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 10



รูปที่ จ.23 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T2 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 10



รูปที่ จ.24 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน T3 ภายหลังทดสอบการกัดกร่อนที่ก่าพีเอช 10

ภาคผนวก ช

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ะ ราว_{วิทยาลัยเทคโนโลยีสุร}บไร

รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

C. Keawhan, P. Songsiriritthigul, N. Witit-Anan, P. Wongpanya, Corrosion Behavior of AISI 4140 Steel Surface Coated by Physical Vapor Deposition. Journal of Metals, Material and Minerals, Vol. 22 No. 1 pp. 69-76, 2012.



Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.22 No.1 pp. 69 - 76, 2012

Corrosion Behavior of AISI 4140 Steel Surface Coated by Physical Vapor Deposition

Chonthicha KEAWHAN¹, Pornwasa WONGPANYA^{1*}, Nirun WITIT-ANUN² and Prayoon SONGSIRIRITTHIGUL³

¹School of Metallurgical Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand, ²Department of Physics, Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand, ³School of Physics, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand, ³Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand,

Abstract

The corrosion behavior of uncoated and CrN-coated onto AISI 4140 steel was studied by electrochemical technique. Firstly, the AISI 4140 steel samples were solution heat treated and oil quenched in order to achieve proper hardness. Then, they were surface-prepared with alteration of surface roughness by using SiC paper at different numbers of 180, 600, and 1200 prior to CrN coating. The samples were coated with CrN film by physical vapor deposition (PVD) technique. The corrosion behavior of the uncoated and CrN-coated samples was studied in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at the pH values of 2, 7 and 10 at room temperature. Before and after corrosion testing, the surface of the uncoated and CrN-coated samples was characterized by scanning electron microscopy (SEM) with chemical composition analysis by energy dispersive X-rays (EDX). The results showed that the CrN-coated samples exhibited lower corrosion rate than the uncoated samples at all pH values. In addition, it was found that corrosion rate of the substrate prior to coating. The finer surface roughness is, the more corrosion resistance is.

Keywords: AISI 4140 steel, Chromium nitride coating, Electrochemical technique, 3.5-wt% NaCl solution.

Introduction

Low alloy steels have been commonly used in many engineering applications, especially parts in the automotive industry such as crankshaft, gear, pinion, bolt and various machine tool components because they have good mechanical properties and they are easily fabricated. In general, those parts are usually used for wear and abrasion applications. Therefore, the parts require high hardness of surface for increasing wear and abrasion resistance. The properties of the parts are focused on wear and hardness.⁽¹⁾ But, in several services they have been used in corrosive environments such as lubricant, gaseous and liquid environments resulting in reduction of performance and lifetime of those parts. As a result, surface modifications, i.e. Physical Vapor Deposition (PVD), Chemical Vapor Deposition (CVD). Carbonitriding and Nitriding, Thermal spraying, are widely used to improve their surface in order to achieve better wear, abrasion and corrosion resistance. However, the PVD technique is a popular method used for improvement of surface because it is safe and clean technology.⁽²⁾ PVD coatings are

Email address: pornwasa@sut.ac.th

KEAWHAN, C. et al.

mostly composed of metal nitrides such as TiAlN, CrN and etc. that are employed as a protective film due to it has good hardness, chemically inert and thermal stability leading to improve corrosion resistance.⁽³⁾ Properties of PVD coatings, such as corrosion, wear and abrasion resistance, depend on various parameters in accordance with type of substrates, microstructure of substrates, thickness and porosity of the PVD coatings. However, it still remains in question about the effective surface roughness of substrate prior to PVD coating on properties of the coating in particular for NaCl solutions with various pHs. In order to understand the effect of surface roughness of substrate on the corrosion behavior of AISI 4140 steel surface coated by physical vapor deposition (PVD) in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, 7 and 10, the electrochemical technique has been used in this study. After electrochemical testing, the corroded surface of samples was investigated by scanning electron microscopy (SEM) with chemical composition analysis by energy dispersive X-rays (EDX).

Materials and Experimental Procedures

Sample Preparation

Low alloy steel with code name AISI 4140 was employed as the substrate in this study. The chemical compositions of AISI 4140 were measured and listed in Table 1. Firstly, the AISI 4140 steels were cut to obtain dimension 10x10x2 mm. After that, the samples were austenitized at 850°C for 30 minutes and oil-quenched. Then, the samples were polished by using SiC at various grit numbers, i.e. 180, 600 and 1200, in order to prepare difference of surface roughness. In addition, the surface roughness (Ra value) of the samples was measured by a profile-meter (Veeco) model as shown in Table 2. Then, the samples were rinsed by distilled water, acetone and were air-dried before PVD coating.

 Table 1 : Chemical compositions of 4140 steel (in wt. %).

Grade	С	Mn	Cr	Si	Mo	Fe
4140	0.47	0.78	0.81	0.26	0.19	bal.

Table 2 : The average surface roughness (Ra).

Substrate	R_a (in nm)			
	Prior to coating	After coating		
180 SiC	563.13	294.32		
600 SiC	200.12	165.56		
1200 SiC	31.14	30.92		

Coating Preparation

The PVD sputtering process was employed to prepare chromium nitride (CrN) coating. The target used for coating process was made of chromium with 99.9% purity. The samples were cleaned in an ultrasonic cleaner for 20 minutes and were dried prior to coating process. The chromium nitride (CrN) coating was deposited onto the samples with the deposition conditions as shown in Table 3.

Table 3 : Deposition conditions of CrN coating.

Ar flow rate	9 sccm		
N ₂ flow rate	6 sccm		
Base pressure	5.0 x 10 ⁻³ mbar		
Working pressure	3.5 x 10 ⁻³ mbar		
Çurrent	800 mA		
Voltage	-456 V		
Deposition time	45 min		
Target-to-substrate spacing	15 cm		
Coating thickness	0.914 μm		

Corrosion Behavior of AISI 4140 Steel Surface Coated by Physical Vapor Deposition

Corrosion Testing

Electrochemical technique was used to study the corrosion behavior of the CrN coating onto the AISI 4140 steel and carried out by using a µ-Autolab software (General Purpose Electrochemical, GPES). A threeelectrode cell was used for the polarization measurements. A silver/silver chloride (Ag/AgCl) electrode and graphite electrode were used as a counter and reference electrode, respectively. The study of corrosion behavior was firstly started by measuring the open circuit potential (OCP). Then, the samples were polarized to potentials ranking from -900 mV to +200 mV at a scan rate of 1.0 mV/s in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, 7 and 10 and 27°C. The pH of solution was adjusted by addition of hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH) for acidic and alkaline solutions, respectively. The tested areas of the samples were 0.85 cm². The polarization curves were used to evaluate corrosion behavior in terms of corrosion potential (Ecorr) and corrosion current density (Icorr) on the basis of the Tafel analysis after potentiodynamic polarization measurements. The corrosion rate (R_{mmy}) was calculated from the corrosion current density after the Faraday's law. Before and after the electrochemical testing, the surface of the uncoated and CrN coated samples was examined by using scanning electron microscopy (SEM) with chemical composition analysis by energy dispersive Xrays (EDX).

Results and Discussion

Effect of CrN Coatings on the Corrosion Behaviour

Figure 1 shows the polarization curves of the uncoated and CrN coated samples with alteration of surface roughness tested in airsaturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, 7 and 10. The polarization curves were recorded from -900 mV to +200 mV with the scan rate of 1.0 mV/s. The important parameters estimated from the polarization curves are listed in Table 4.

 Table 4 : Important values evaluated from the polarization curves of uncoated and CrN coated samples tested in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution.

pН	Samples	Sic paper	Ecorr	lcorr	Rmmy
pH2	Uncoated	Nó.180	-571	10.98	0.1289
		No.600	-636	5.55	0.0652
		No.1200	-572	5.19	0.0609
	CrN	No.180	-538	7.43	0.0219
		No.600	-531	2.00	0.0059
		No.1200	-532	0.89	0.0026
	Uncoated	No.180	-533	8.11	0.0952
pH7		No.600	-532	3.40	0.0399
		No.1200	-599	0.60	0.0071
	CrN	No.180	-485	0.77	0.0023
		No.600	-455	0.60	0.0018
		No.1200	-405	0.36	0.0011
pH10	Uncoated	No.180	-587	0.68	0.0080
		No.600	-596	0.67	0.0079
		No.1200	-560	0.45	0.0053
	CrN	No.180	-473	0.70	0.0021
		No.600	-423	0.59	0.0017
		No 1200	354	0.10	0.0003

E_{corr} Corrosion potential (mV, Ag/AgCl) I_{corr} Corrosion current density (μA/cm²) R_{mmy} Corrosion rate (mm/year)

It is obvious that the CrN coating significantly affects corrosion properties of the AISI 4140 steel in particular the corrosion potential (E_{corr}) and corrosion current density (I_{corr}). From the comparison of the corrosion potential (E_{corr}) of the CrN-coated samples and uncoated samples, it is found that the corrosion potential (E_{corr}) is shifted to more positive value, if the samples were surface-coated by CrN.



Figure 1 : The polarization curves of uncoated and CrN-coated samples tested in air - saturated 3.5 wt% NaCl solution.

For example, at pH 2 the corrosion potential (E_{corr}) of the uncoated sample with the highest surface roughness (No.180) is - 571 mV, while the corrosion potential (E_{corr}) of the CrN-coated sample is increased to - 538 mV. And, there is the same trend at pH 7 and pH 10. In addition, it is found that the CrN-coated samples have lower corrosion

KEAWHAN, C. et al.

current densities (I_{corr}) than the uncoated samples at all pHs.⁽⁴⁾ Those results indicate that after application of CrN coating onto the surface of bare steel, the corrosion resistance is better. The reason, why CrN enhances the corrosion resistance, is due to the fact that nitrogen atom in the nitride layer firstly dissolved into the solution, and it could repel the Chloride ion (Cl[°]) away from the sample surface. The nitrogen anion (N[°]) then combines with hydrogen ion (H⁺) in the solution to form the ammonium (NH4⁺) resulting increase of solution pH. Finally, corrosion attack from the solutions decreases.^(5,6)

Effect of pH of Solution on Corrosion Behaviour

In order to study the effect of pH of solution on corrosion behavior of the uncoated and CrN coated samples tested in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution, the solution was pH adjusted by addition of hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH) for pH 2 and 10, respectively. Then, the corrosion testing was done at the same procedure. From the polarization curves, shown in Figure 1, corrosion rate in terms of millimetre per year (mm/yr) is calculated and plotted with various pHs of solution as shown in Figure 2.





Corrosion Behavior of AISI 4140 Steel Surface Coated by Physical Vapor Deposition

It is obvious that the corrosion rate decreases as the pH of solution increases. The highest corrosion rate is observed at pH 2 because the solution was adjusted by HCl acid that significantly increased chloride (Cl⁻) ion and hydrogen ion (H⁺) in the solution. This means that the solution at pH 2 is more aggressive than that at pH 7 and pH 10. The corrosion attack is more severe in the uncoated samples than in the CrN-coated samples. Even though the Cl ion still attacks the CrN coating as the same in the uncoated samples, corrosion appearance is not the same. Because the Cl ion attacks at the specific area of CrN coating i.e. pore and crack, then it penetrates to the substrate resulting in pitting corrosion.⁽⁷⁾ Moreover, there is more available hydrogen ion (H⁺) in solution causing H₂ evolution resulting increase in the corrosion rate at pH 2 more than pH 7 and 10. At pH 10, it was found that the uncoated sample with the smoothest surface shows passive behavior. This is due to the fact that iron can form hydroxide film at basic pH more than 7.⁽⁸⁾ As a result, the corrosion resistance in basic solution is better than in acid solution.

Effect of Surface Roughness on Corrosion Behavior

In order to investigate the effect of surface roughness on corrosion behavior, the samples prior to PVD coating were surfaceprepared by using different SiC numbers. The average surface roughness in R_a values of each sample both before and after coating was measured by using the profile-meter (Veeco) model as listed in Table 2. It clearly demonstrates that the average surface roughness (R_a) of the samples prior to coating decreases with the number of grinding paper increases. Moreover, it is obvious that the surface roughness of sample prior to coating also affects the surface roughness of the CrN- coated samples. The effect of surface roughness of uncoated samples on corrosion rate at pH 2, 7 and 10 is shown in Figure 3. It is obvious that corrosion rate significantly increases with the surface roughness of the substrate, especially at pH 2 and pH 7. In case of pH 7, surface roughness slightly affects the corrosion rate. Figure 4 also shows effect of surface roughness on corrosion rate of the CrN-coated samples. It is obvious that the CrN coated onto the rougher surface has a higher corrosion rate than the CrN coated onto the smoother surface. The evidence of increasing corrosion rate can be observed at pH 2. In contrast to pH 2, there is slightly increasing of corrosion rate at pH 7 and 10. This is due to the fact that higher surface roughness leads to a higher number of defects in the coating and also results in lower complete coverage of the sample by the coating. Those results also have the same trend as shown in the uncoated samples. And, those can be used to confirm that the surface roughness of substrate prior to coating significantly effects on the deposition of CrN film.(9,10)







Figure 6: The EDX analysis of spectrum A.

8.00 10.00

12.00 14.00

16.00



shown that the CrN film represents as a

protective film which can be used to reduce

corrosion attack of NaCl solution. In addition,

of the CrN film drastically depends on the roughness of substrate and pH of solution. For example, the CrN coated samples with the highest surface roughness and tested in solution at pH 2 (Figure 7a) exhibit the worst corrosion resistance. This is due to the fact that some parts of the CrN film break and remove from the substrate resulting in the ion penetrates easily into the CrN coating and attacks the surface of substrate. The breakdown of the CrN film is a result from an imperfection of adhesion between the CrN coating and substrate. In contrast, the CrN coated samples with smoother surface and tested at pH 7 and 10 almost have no corroded area as shown in Figure 7b and 7c. From those results, it is corresponding to the previous results ⁽¹¹⁾ that corrosion resistance of the samples is better, if the surface of samples is smoother and pH of solution is higher.

the results show that the corrosion resistance

Conclusions

The corrosion behavior of AISI4140 steel surface coated with chromium nitride (CrN) film by physical vapor deposition (PVD) was studied. The following conclusions are:

- 1. The CrN coated samples exhibited better corrosion resistance than the uncoated samples in 3.5 wt% NaCl solution at all pH values.
- 2. The corrosion resistance of the uncoated and CrN coated samples significantly altered with pH of solution. And, the corrosion resistance of the samples at pH 10 was better than at pH 7 and pH 2 respectively.
- 3. The surface roughness of substrate prior to coating significantly effected on the deposition and breakdown of CrN film during corrosion testing. And, the

KEAWHAN, C. et al.

corrosion rate increased with increasing surface roughness of substrate.

The corroded area in the CrN-coated samples was less than that in the uncoated samples.

Acknowledgments

The authors gratefully acknowledge the financial support of this work by Office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and Suranaree University of Technology with the Contract No. 61/2553 and Code name SUT7-713-53-24-35.

References

- Sivitski, A., Ajaots, M. and Podra, P. (2008). Wear PVD Hard Coatings in Sliding Contacts. In: Proceedings of the 6th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering. Tallinn, Estonia: 549-554
- Darja, K.M., Peter, P., Miha, C. and Marijan, M. (2004). The corrosion behavior of Cr-(C,N) PVD hard coatings deposited on various substrates. *Electrochim. Acta* 49 (9-10): 1527-1533.
- Zhou, Q.G., Bai, X.D., Chen, X.W., Peng, D.Q., Ling, Y.H. and Wang, D.R. (2003). Corrosion Resistance of Duplex and Gradient CrN_x Coated H13 Steel. *Appl. Surf. Sci.* 211 (1-11): 293-299.
- Cunha, L., Andritschky, M., Rebouta, L. and Pischow, K. (1999). Corrosion of CrN TiAlN coatings in chloride containing atmosphere. *Surf. Coat. Technol.* 116-119 : 1152-1160.

- Chyou, S. D. and Shih, H. C.(1991). The effect of nitrogen on the corrosion of plasma - nitrided 4140 steel. *Corrosion.* 47(1): 31-34.
- Grabke, H. J. (1996). The role of nitrogen in the corrosion of iron and steels (review). *ISLJ. Int.* 36(7): 777-786.
- Hui, P.F., Cheng, H.H., Jung, K.L. and Yih, H.S. (2003). Effects of PVD sputtered coating on the corrosion resistance of AISI304 stainless steel. *Mater. Sci. Eng.* 347(1-2): 123-129.
- Jones, D. A. (1996). Principles and prevention of corrosion. 2nd ed. London : Prentice Hall : 292-304.
 - Liu, C., Leyland, A., Lyon, S. and Matthews, A. (1995). An a.c impedance study on PVD-coated mild steel with different surface roughness. *Surf. Coat. Technol.* (part2): 76-77:623-631.
- Walter, R. and Bobby Kannan, M. (2011). Influence of surface roughness on the corrosion behavior of magnesium alloy. *Mater. Des.* 32(4): 2350-2354.
- Ahn, S.H., Yoo, J.H., Choi, Y.S., Kim, J.G. and Han, J.G. (2003).
 Corrosion behavior of PVD-Grown WC-(Ti_{1-x} Al_x)N Films in a 3.5 wt% NaCl solution. *Surf. Coat. Technol.* 162(2-3): 212-221.

ประวัติผู้เขียน

นางสาวชลธิชา แก้วหาญ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดทหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2547 และสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2551 หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2553 โดยได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับบัญฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้

(1) C. Keawhan, P. Songsiriritthigul, N. Witit-Anan, P. Wongpanya, Corrosion Behavior of AISI 4140 Steel Surface Coated by Physical Vapor Deposition. Journal of Metals, Material and Minerals, Vol. 22 No. 1 pp. 69-76, 2012.

